특허종합소식지 특허는 재산 • 기술은 힘 • 정보는 생명

10.2003 / No.52

Patent 21

www.kipi.or.kr

특집

국내 다출원 10개 단체의 특허 출원 분석

한국내 독일의 특허활동

기획

실용신안 기술 평가의 정정청구 제도

KIPI NEWS

특허청 NEWS

한국특허정보원
Korea Institute of Patent Information

CONTENTS

인사말

원장 유영기 ····· 2

특집

1. 국내 다출원 10개 단체의 특허 출원 분석 ····· 3
2. 한국내 독일의 특허활동 ····· 13

기획

실용신안 기술 평가의 정정청구 제도 ····· 18

KIPI NEWS

한국특허정보원 신임 원장에 유영기 전 특허심판원 심판장 취임 ····· 24

한국특허정보원 관리본부장에 이종익 전 특허청 출원과장 선임 ····· 25
– 사업본부장에는 이재정 현 본부장이 선임

한국특허정보원, 일본특허페어 2003 참가 ····· 25

해외특허청 관계자 한국특허정보원 방문 ····· 26

특허청 NEWS

난치성 질환, 인간화 항체로 정복한다. ····· 27

국제특허분류(IPC), 이렇게 달라진다. ····· 28

유명 스타들의 성명을 사용한 상표출원 급증 ····· 30

'IT 지적재산권 풀' 제도 국내 처음 도입 ····· 31

우리나라 특허권 말레이시아에서도 인정받는다. ····· 32

인사말

친애하는 특허가족 여러분 !

국내 최고의 특허정보서비스 전문기관인 한국특허정보원에 새로 취임하여 여러분을 뵙게 되어 진심으로 반갑습니다.

민경탁 전임 원장께서 지난 기간동안 헌신적인 노력으로 비약적인 성장을 일구며 남기신 커다란 업적을, 부족한 제가 이어나갈 수 있게 되어 참으로 기쁘게 생각합니다.

한국특허정보원은 지난 95년 설립 이래, 여타 기관에서는 유래 없는 놀라운 성장과 발전을 거듭하여 오늘날 국내 최고의 특허정보서비스 전문기관으로 자리매김 하였습니다. 이와 같은 성장과 발전의 원동력은 무엇보다 한국특허정보원 임직원이 고군분투한 결과이며, 또한 특허가족 여러분의 따뜻한 성원과 관심이 지대한 공헌을 했음은 두말할 필요가 없다고 하겠습니다.

한국특허정보원은 우수한 두뇌와 전문 지식을 갖춘 고급 인력으로 구성되어 있으며, 특히 젊음과 패기를 두루 겸비한 창조적인 조직으로 정평이 나 있음은 특허청 재직 시절 익히 들어왔습니다. 이처럼 젊고 창조적인 조직에서 함께 일할 수 있게 되어 무한한 영광으로 생각하며, 같은 특허업계에 몸담았던 저로서는 특허가족 여러분과 만나는 것이 생소함보다는 친근함이 앞섭니다.

전 세계가 지식정보화 사회로 급변하고 있는 시점에서 우리나라는 이미 세계적인 특허 선진국으로서의 위치를 확고히 하였으며, 특히 첨단 특허행정시스템 구축을 통해 전자정부 구현 및 정보화를 실현하고 있어 이에 대한 경쟁력 유지 방안이 더욱 활발하게 요구되고 있습니다.

따라서 한국특허정보원은 우리나라 특허 경쟁력을 확고히 하고 보다 강화하기 위해 특허정보원 본연의 업무인 특허정보 보급 활성화, 특허정보조사분석의 내실화는 물론, 특허행정의 원활한 지원을 위해 더욱 힘써야 할 것입니다.

저는 이를 위해 한국특허정보원의 운영방침으로 세 가지를 제시하고자 합니다.

첫째, 국정원리의 적용입니다.

참여정부의 국정원리인 '원칙과 신뢰', '공정과 투명', '대화와 타협', '분권과 자율'의 문화를 한국특허정보원 운영에 적용하여 한층 성숙되고 발전된 조직으로 이끌어 나가겠습니다.

둘째, 윤리경영의 실시입니다.

한국특허정보원이 보다 신뢰받는 정부산하기관으로 거듭나기 위해 고객감동 서비스를 통한 지식정보화 사회 구축을 기본 모토로, 투명하고 깨끗한 기관 이미지 제고에 노력하겠습니다.

셋째, 품질경영기법의 활용입니다.

효율적인 우수한 선진 경영기법 도입을 통해 품질우선의 효율적인 사업수행을 도모하여 양질의 서비스 제공과 함께 특허청의 정확한 특허심사 및 기간 단축을 위해 최선의 노력을 다할 것입니다.

이와 같은 운영방침을 바탕으로 앞으로 한국특허정보원을 이끌어갈 방안을 말씀드리면, 먼저 한국특허정보원의 효율적인 조직 운영 및 활성화를 도모하겠습니다.

2본부 체제를 통해 경영혁신의 기반을 강화하는 동시에 부서간의 원활한 의사소통체제 구축, 성과목표관리 및 합리적 평가제도 운영에 의한 조직 내부 경쟁력 강화, 효율적인 노사협의회 운영을 통한 화합하는 직장문화 창출 등을 실현하겠습니다. 아울러 다양한 복리후생의 강화로 직원들의 사기 진작 제고, 권한 및 책임의 명료화를 통해 책임경영 실현을 위해 최선의 노력을 경주할 것입니다.

둘째, 인재확충 및 개발입니다.

인력의 채용에서 육성까지 전략적 인력관리시스템과 인재육성 시스템을 마련하여 전문 인력을 개발하겠습니다. 철저한 인사고과시스템 구축으로 공정하고 합리적인 능력평가를 구현하고 내부 핵심전문가 양성을 위해 사내외 교육지원을 아끼지 않겠습니다.

셋째, 신경영 모델 도입을 통한 경영효율성 제고를 위해 경영정보, 지식공유, 인적자원관리 등 첨단 신경영체제를 정보원 실정에 맞게 도입하여 경영환경을 개선하겠습니다.

넷째, 재무구조의 개선입니다.

정보원의 경영효율화, 정부용역사업의 수지개선, 대민서비스의 활성화 등을 통해 사업구조의 개선 및 다각화를 실현하여 안정적인 발전방향을 모색할 것입니다.

이러한 저의 방침과 소신이 결실을 맺기 위해서는 무엇보다 특허가족 여러분의 지혜와 역량과 함께 적극적인 참여가 뒷받침되어야 함은 두말할 나위가 없습니다. 여러분과 저의 노력과 열정을 한데 모아 한국특허정보원의 희망찬 미래를 위해서 함께 뛰어봅시다.

특허가족 여러분의 앞날에 건승과 가정에 행운이 깃드시기를 기원합니다. 감사합니다.

院長 兪永基

국내 다출원 10개 단체의 특허 출원 분석

조사분석1팀 이태현
조사분석3팀 백종근
조사분석4팀 한동희

Ⅰ. 서 론

본 보고서는 국가특허경쟁력 분석을 위한 기초통계 데이터의 정비 및 분석을 위하여 특허청과 한국특허정보원에서 발간한 "한국의 특허동향 2002"에서 사용되었던 데이터를 기준으로 하여 1982년에서 1999년 사이의 국내에 출원된 특허를 연도별, 출원인별 및 분류별로 분석하여 국내 다 출원인 10개를 선정하였고, 각 각의 출원인별 출원분야를 비교 분석한 것이다.

국내에 공개된 유효 데이터중 1982년 1월1일 부터 1999년 12월 31일까지 출원된 총 677,835건을 조사대상으로 하였으며, 기술분야별적용기준은 WIPO 기준 32개 기술분야(IPC 6판)를 적용 하였다. 내국인 출원인중 기업, 공공기관, 대학 및 기타 비영리 민간단체 및 개인의 출원을 총괄하여 상위 다 출원 단체를 선정하였다. 그리고 출원인의 명칭이 변경된 부분에 대하여는 하나의 통일된 명칭(예, 럭키금성 -> 엘지전자)으로 표기하였다.

Ⅱ. 본 론

가. 다출원 10개 단체

1) 국내 특허출원 다출원 기업/단체

순위	명칭	출원건(건수)	국적
1	삼성전자	75,676	한국
2	엘지전자	37,433	한국
3	하이닉스반도체	37,371	한국
4	대우전자	31,963	한국
5	현대자동차	22,881	한국
6	기아자동차	17,537	한국
7	대우자동차	12,935	한국
8	도시바	7,413	일본
9	소니	7,080	일본
10	ETRI	6,776	한국
11	히다찌	6,415	일본
12	포철	6,109	한국
13	삼성SDI	5,048	한국
14	미쓰비스	4,740	일본
15	NEC	4,719	일본
-	국내전체	677,835	-

표 1. 국내 다출원인

<표 1> 에서와 같이 1982년부터 1999년 까지의 출원중 국내출원 다출원인 10개 단체중 일본국적의 도시바와 소니가 각각 8위와 9위를 차지하였고, 본 보고서에서는 이들 외국업체를 제외한 순수 국내국적 10개 단체를 선정하여 이들의 출원분야와 경향을 분석하였다. 또한 위의 표 외에도 네덜란드계 필립스사(4,310건), 삼성전기(4,088건), 대우통신(3,897건), 한국전기통신(3,064건), 만도(2,890건) 등이 있었다.

2) 10개 단체의 출원점유율

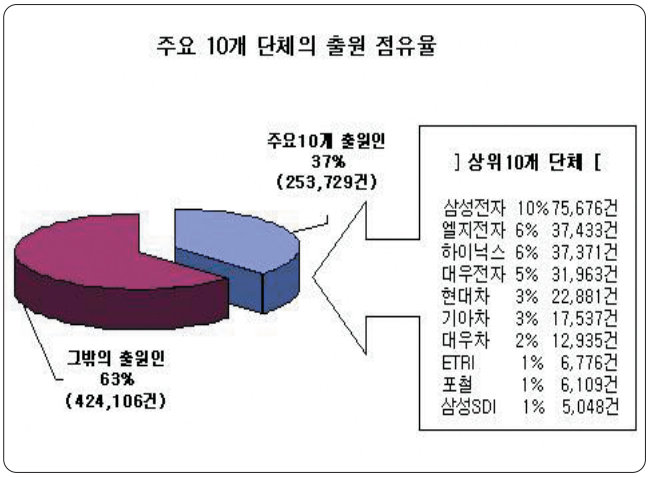


그림1. 주요10개 다출원인

<그림 1> 에서와 같이 1982년에서 1999년까지의 출원 총 677,835건 중 상위 10개 단체가 총 253,729건을 출원하여 국내 전체 출원건수에 비교하여 37%의 점유율을 보였고, 그중 가장 출원이 많았던 삼성전자는 75,676건을 출원하여 전체대비 10%의 비중을 차지하였다. 이는 국내의 기업구조가 대기업구조의 형태를 취하고 있으며, 특허출원에 있어서도 이들 대기업위주로 출원이 이루어지고 있음을 알 수 있다.

3) 10개 단체의 연도별 출원동향

국내 다 출원 10개 단체는 출원인의 주요 업종별로 대략 A)전기. 전자. 통신. 반도체 업종 출원인과 B)기계. 금속. 화학 업종 출원인으로 분류하여서 각각의 연도별 출원동향을 살펴본다.

A 전기, 전자, 통신, 반도체 분야 6개 기업의 출원동향

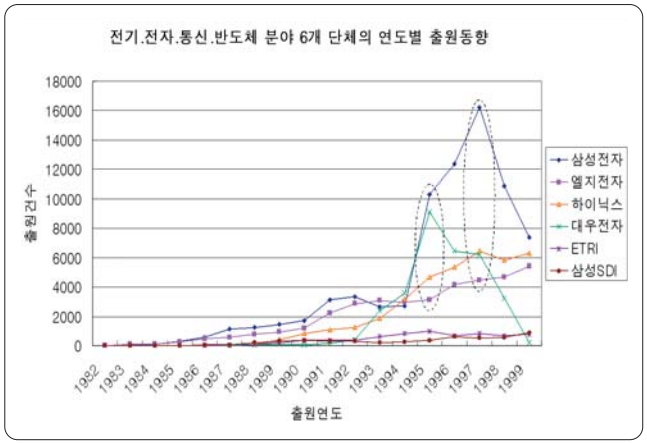


그림2. 전기·전자·통신·반도체 분야 6개 단체의 출원동향

<그림2>와 같이 전기, 전자, 통신, 반도체분야 주요 6개 기업의 전반적인 출원동향을 살펴보면, 전체적으로 대부분의 기업이 1994년 이후 출원량의 증가가 뚜렷하게 드러난 반면 대우전자는 1996년부터, 그리고 삼성전자는 1998년부터 출원량의 급격한 감소추세를 보여주고 있다.

B 기계, 금속분야 4개 업체의 출원동향

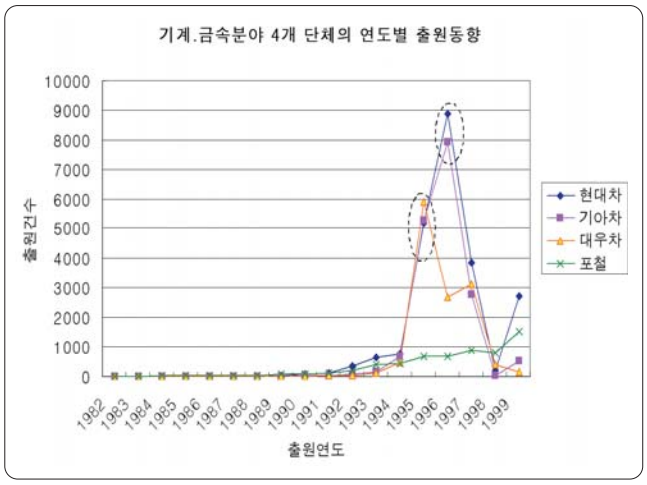


그림 3. 기계·금속·화학분야 4개 단체의 출원동향

<그림 3> 에서 볼 수 있듯이 기계(자동차관련), 금속, 화학분야 4개 기업의 연도별 출원 동향을 보면, 자동차관련 완성차 업체인 현대자동차와 기아자동차 및 대우자동차(현재의 GM대우)의 출원량이 동반하여 1994년 이후 급증 하였으며, 대우자동차는 1996년 이후, 현대자동차 및 기아자동차는 1997년 이후 출원량이 급격히 감소하여 유사한 출원량의 증감추세를 보여주고 있다. 반면 금속업종에 속하는 포항제철의 출원량은 꾸준히 증가하였다.

<그림 2>의 전기, 전자, 통신, 반도체분야와 비교하여 보면, 기계(자동차관련)분야의 3개 기업은 1997년말 국내의 외환위기 당시 출원량의 감소폭이 훨씬 커졌음을 보여주고 있다.

나. 다출원 10개 단체의 출원동향

1) 삼성전자

A 삼성전자의 연도별 출원건수 및 출원분야

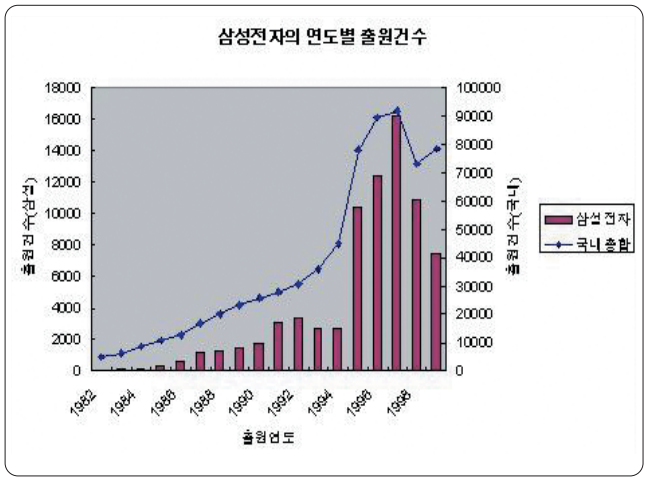


그림 4. 삼성전자의 연도별 출원동향

삼성전자는 국내전체 출원 677,835건 중 75,676건을 출원하여 약 11%의 출원점유율과 함께 가장많은 출원을 하였다. <그림 4>와 같이 삼성전자의 전체적인 출원량은 국내전체출원 증감추이와 대체로 비슷한 양상을 보였으며, 1995년에는 10,326건의 출원을 하여 1994년(2,678건)대비 약 3.8배 증가하였다. 또한 1987년 1,158건의 출원에서 1997년에는 16,210건으로 10년 사이에 출원량이 약 14배 성장하였다.

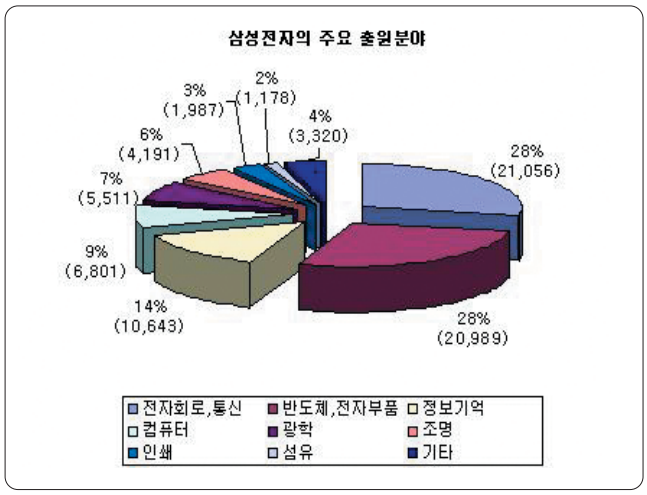


그림5. 삼성전자의 주요 출원분야

<그림 5> 와 같이 삼성전자의 출원분야는 전체적으로 전자회로, 통신분야(H03, H04)와 반도체, 전자부품(H01,H02,H05)분야가 삼성전자 전체 출원의 56%(42,045건)를 차지하였고, 정보기억(G09~G12)분야와 컴퓨터(G04~G08)분야가 그 다음으로 출원이 많았다. 이중 최근 5년간(1995년~1999년)의 출원동향을 보면 반도체, 전자부품의 출원량(5년간 총 57,183건 중)이 17,312건에 이르러 삼성전자출원 중 가장 높은 점유율(29%점유)을 보였다.

B 삼성전자의 기술집중도(AI)

삼성전자	82~84	85~89	90~94	95~99	AI 평균	AI 순위	점유율(국내출원)	AI(90년말~80년말)
조명, 가열, 공조	2.28	0.88	1.24	1.59	1.57	6	18.0%	0.71
반도체, 전자부품	2.47	1.09	1.37	1.64	1.64	5	18.0%	0.55
섬유	0.32	0.42	0.44	0.94	0.71	8	8.0%	0.52
광학	0.89	0.88	1.10	1.27	1.24	7	14.0%	0.39
인쇄(프린터)	0.00	2.10	2.21	2.47	2.26	1	25.0%	0.37
플라스틱가공	0.43	0.07	0.42	0.25	0.25	10	3.0%	0.18
가정용품	0.00	0.28	0.49	0.32	0.34	9	4.0%	0.04
정보기억	4.38	2.67	2.42	1.83	2.03	3	23.0%	−0.84
컴퓨터	3.38	3.15	1.70	1.62	1.74	4	19.0%	−1.53
전자회로, 통신	5.31	4.77	2.64	1.79	2.16	2	24.0%	−2.98

그림 6. 삼성전자의 AI

국내의 특정분야에 대한 출원비중에 대한 삼성전자의 분야별 출원집중도를 나타내는 A.I 지수에 있어서, <그림 6> 에서와 같이 1982년에서 1999년에 이르기까지 전체적으로 보면 인쇄(프린터)분야와 전자회로, 통신분야가 가장 높게 나타나며, 역시 국내전체의 출원점유율에서도 가장 높게 나타나고 있다. 한편 90년대말(95년~99년)과 80년대말(85년~89년)의 AI지수를 비교하면 조명, 가열, 공조(냉온방)분야 및 반도체, 전자부품분야가 가장 높게 나타나고 있으며, 컴퓨터분야와 전자회로, 통신분야가 비교적 낮게 나타나고 있는데 이는 컴퓨터분야와 전자회로, 통신분야에 있어서 국내의 경쟁업체들의 상대적인 출원이 많았기 때문인 것으로 분석된다.

C 인쇄(프린터)분야에서의 삼성전자를 포함한 주요기업의 출원동향.

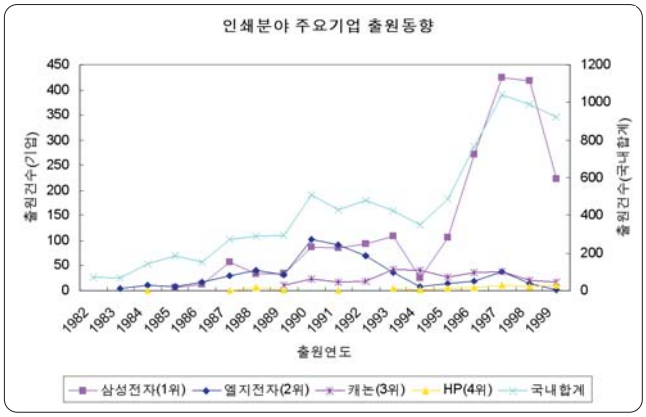


그림 7. 인쇄분야의 주요기업 출원동향

기타 기업과 비교하여 삼성전자는 인쇄(프린터)분야에 있어서 전체의 4분의1에 해당하는 1,987건을 출원하여 가장 많은 출원을 하였다. 그 뒤를 이어 엘지전자(540건)와 외국계 기업인 캐논(296건) 및 HP(149건)순으로 출원하였고 1995년 이후에는 출원량의 격차가 더욱 커졌다.

D 전자회로, 통신분야에서의 삼성전자 및 주요경쟁기업의 출원동향

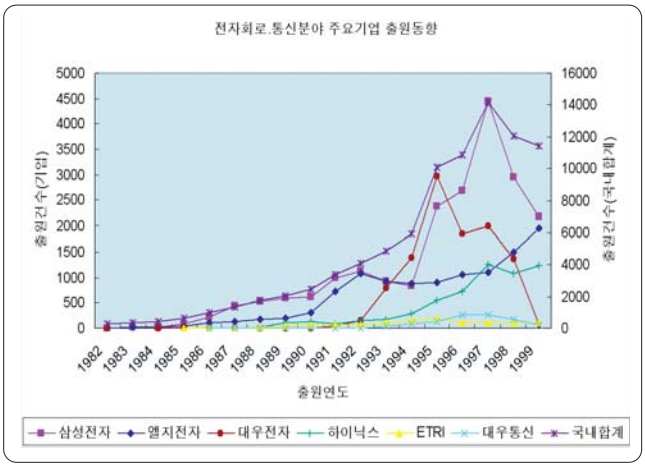


그림 8. 전자회로, 통신분야의 주요기업의 출원동향

전자회로, 통신분야에 있어서 전체적으로 삼성전자가 21,056건으로 가장 많은 출원을 하였고, 엘지전자(11,177건)와 대우전자(10,671건) 그리고 하이닉스의 순서로 많은 출원을 하였다. 90년대 중반이후 삼성전자의 출원이 가파르게 상승하였고, 대우전자의 출원량이 급격히 줄어듬을 보였다. 또한 ETRI와 대우통신의 출원량도 꾸준히 지속되었다.

2) 엘지전자(주)

A 엘지전자의 연도별 출원동향 및 출원분야

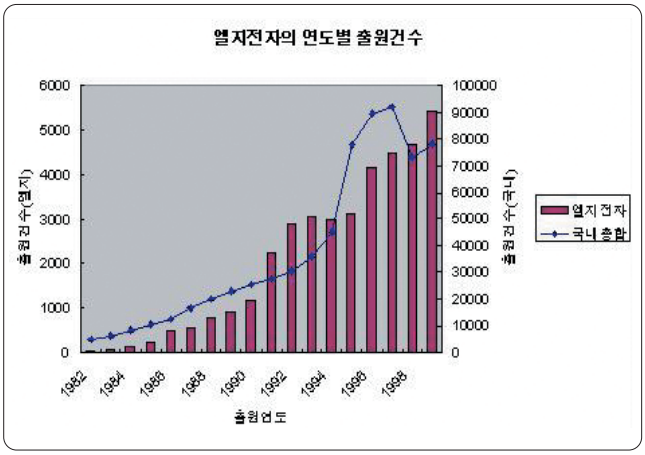


그림 9. 엘지전자의 연도별 출원동향

엘지전자는 37,433건을 출원하여 국내전체 출원 중 약 6%를 차지하였고, 연도별 출원동향은 <그림 8>에서 알 수 있듯이 갑작스런 출원의 증감 없이 꾸준히 증가하였으며, 특징적으로 국내전체 출원량의 감소시기였던 1998년경에도 출원량이 꾸준히 증가하였다.

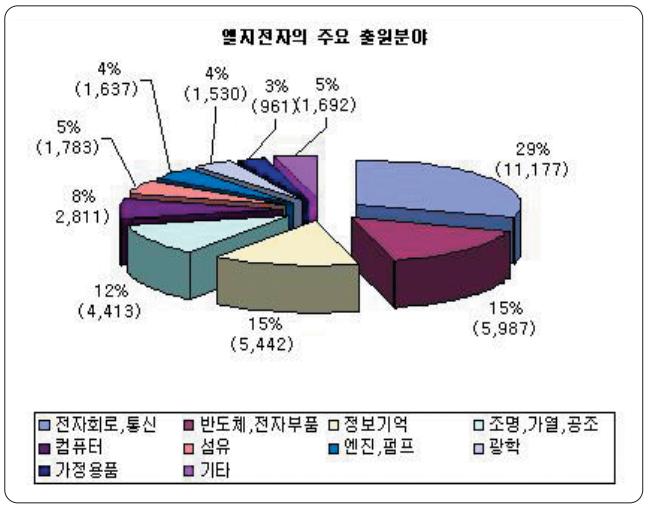


그림 10. 엘지전자의 주요 출원분야

엘지전자는 <그림 9> 에서와 같이 전자회로, 통신분야에서 엘지전자 전체 출원량의 29%를 차지하여 가장 많은 출원이 이루어졌고, 반도체, 전자부품분야와 정보기억분야 및 조명, 가열, 공조분야에서 골고루 출원이 이루어져 있다.

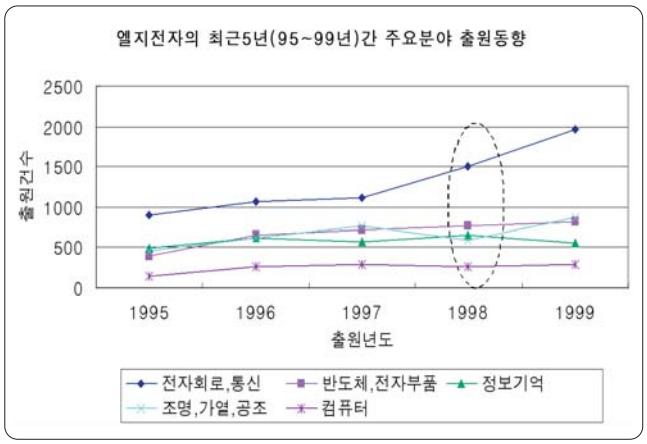


그림 11. 엘지전자의 최근5년 주요분야 출원동향

<그림 10>은 엘지전자의 최근 5년동안 주요분야에 대한 출원동향을 나타낸 것이며, 국내의 외환위기가 있었던 97년말 이후에도 엘지전자 출원량이 기타기업과 같이 감소를 보이지 않고 증가하였던 바 이는 전자회로, 통신분야에 있어서의 출원이 급증하고 반도체, 전자부품 및 정보기억분야에 있어서 출원이 증가하였던 결과로 분석된다.

B 엘지전자의 기술집중도(AI)

엘지전자	82~84	85~89	90~94	95~99	AI 평균	AI 순위	점유율(국내출원)	AI(90년말~80년말)
섬유	0.00	0.62	1.48	3.12	2.17	3	12.0%	2.50
조명, 가열, 공조	0.27	1.47	2.53	3.87	3.34	1	18.0%	2.40
가정용품	0.00	0.50	1.54	1.90	1.62	5	9.0%	1.40
엔진, 펌프	0.15	0.46	0.81	1.55	1.26	7	7.0%	1.09
광학	2.22	1.01	0.92	0.51	0.69	10	4.0%	−0.50
전자회로, 통신	4.35	2.75	2.52	2.09	2.32	2	13.0%	−0.66
반도체, 전자부품	1.50	1.80	0.97	0.83	0.95	9	5.0%	−0.97
정보기억	3.45	2.94	2.29	1.84	2.10	4	12.0%	−1.10
컴퓨터	4.65	2.64	1.68	1.11	1.46	6	8.0%	−1.53
인쇄	0.00	2.95	1.88	0.40	1.24	8	7.0%	−2.55

그림 12. 엘지전자의 AI

엘지전자는 국내출원 중 18%의 점유를 보이는 조명, 가열, 공조분야에 있어서 AI가 가장 높았고, 전자회로, 통신분야에서 그 뒤를 이었지만, 엘지전자 전체의 15%를 차지하였던 반도체, 전자부품 분야에 있어서는 국내에 상대적으로 적은 출원점유율과 출원집중도를 나타냈다. 또한 90년대 말과 80년대 말의 AI 변동을 보면 섬유(D06F,세탁기분야포함)분야가 가장 크게 집중도가 성장 하였음을 나타내었다.

C 조명,가열,공조분야에서 엘지전자 및 주요기업의 출원동향

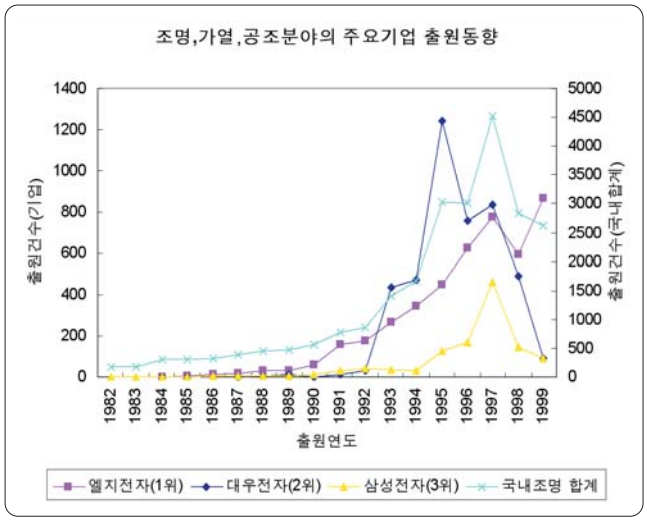


그림 13. 조명,가열,공조분야의 주요기업 출원동향

<그림 12>에서와 같이 조명, 가열, 공조분야(예, 냉장고, 에어컨)에서 엘지전자는 전체 23,901건 중 4,413건을 출원하여 가장 많은 출원을 하였고, 1990년대 중반이후 대우전자 및 삼성전자와 같은 주요경쟁기업의 출원이 급감하였으나 엘지전자는 출원량이 꾸준히 성장하였다. 이런 결과로 인하여 엘지전자의 조명, 가열, 공조분야의 출원집중도가 1990년대 말 높게 나타나고 있는 것으로 분석된다.

3) 하이닉스반도체(주)

A 하이닉스의 연도별 출원동향 및 출원분야

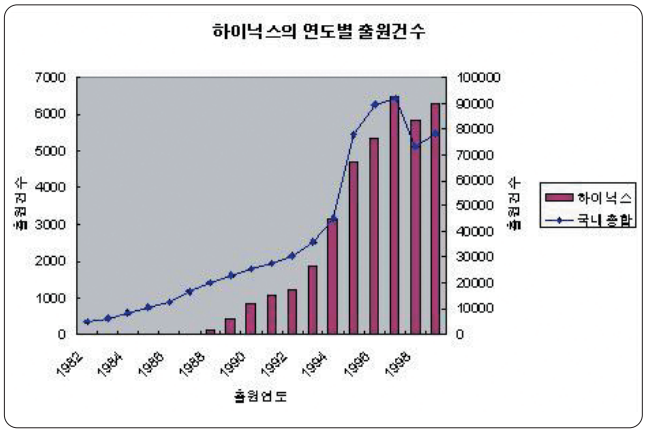


그림 14. 하이닉스의 연도별 출원동향

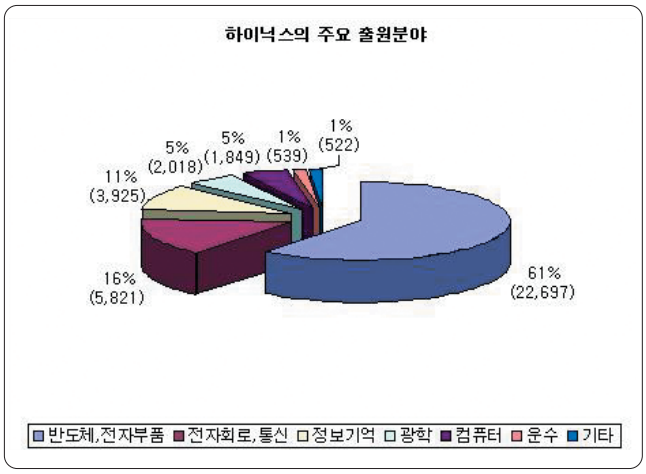


그림 15. 하이닉스의 주요 출원분야

하이닉스는 1980년대 후반부터 출원이 있기 시작하여 1990년을 거치며 출원량이 대폭 상승하였다. 하이닉스는 반도체, 전자부품분야 출원 비중이 61%를 차지하며 반도체분야의 출원을 다수 하였고, 전자회로.통신(H03,H04), 정보기억, 광학분야 등의 출원은 상대적으로 적게 되었다.

B 하이닉스의 기술집중도(AI)

하이닉스는 반도체,전자부품분야에 있어서 전체적으로 국내출원점유율 및 AI 가 3.60으로 가장 높았으며, 정보기억 및 전자회로,통신분야에서도 높게 나타났다. 또한 90년대말과 80년대말을 비교한 수치에 있어서는 정보기억분야가 높게나타난반면, 상대적으로 반도체,전자부품분야와 전자회로,통신분야가 낮게 나타났는데 이는 상대적으로 경쟁기업의 출원이 더 많이 늘어났기 때문인 것으로 분석된다.

하이닉스	82~84	85~89	90~94	95~99	AI 평균	AI 순위	점유율(국내출원)	AI(90년말~80년말)
정보기억	–	1.08	1.01	1.61	1.51	2	8.0%	0.53
건설	–	0.00	0.12	0.05	0.06	9	0.0%	0.05
야금	–	0.08	0.19	0.08	0.10	8	1.0%	0.00
분리,혼합	–	0.16	0.11	0.05	0.06	10	0.0%	−0.11
광학	–	0.95	1.16	0.83	0.92	5	5.0%	−0.12
운수	–	0.28	0.41	0.15	0.20	6	1.0%	−0.13
인쇄	–	0.26	0.46	0.06	0.16	7	1.0%	−0.20
컴퓨터	–	1.52	1.02	0.92	0.96	4	5.0%	−0.60
반도체,전자부품	–	4.23	4.12	3.21	3.60	1	20.0%	−1.02
전자회로,통신	–	2.90	0.83	1.18	1.21	3	7.0%	−1.72

– "–"는 하이닉스의 출원이 없어서 AI 산정불가

그림 16. 하이닉스의 AI

C 반도체, 전자부품분야에서의 하이닉스 반도체 및 주요기업의 출원동향

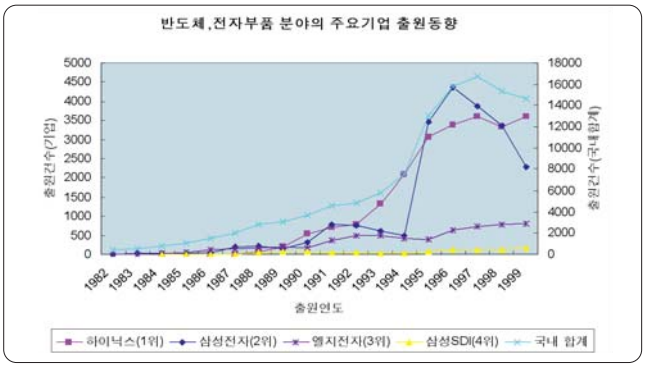


그림 17. 반도체,전자부품분야의 주요기업 출원동향

<그림 16>과 같이 하이닉스는 다른 경쟁업체에 비하여 상대적으로 늦게(1996년 반도체 연구소 설립) 출원이 있었지만 1990년대 초반이후 출원이 대폭 증가하여 총 22,697건을 출원하여 가장 많은 출원을 하였고, 삼성전자가 20,989건을 출원하여 그 뒤를 잇고 있다. 1997년 이후 삼성전자의 반도체, 전자부품관련 출원이 감소하는 반면 하이닉스는 출원량이 증가하고 있다.

4) 대우전자

A 대우전자의 연도별 출원동향 및 출원분포.

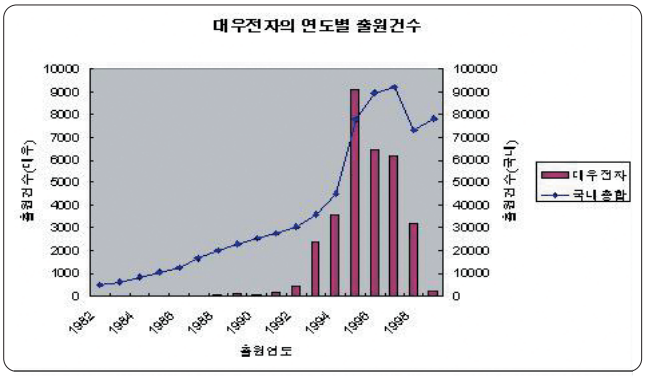


그림 18. 대우전자의 연도별 출원동향

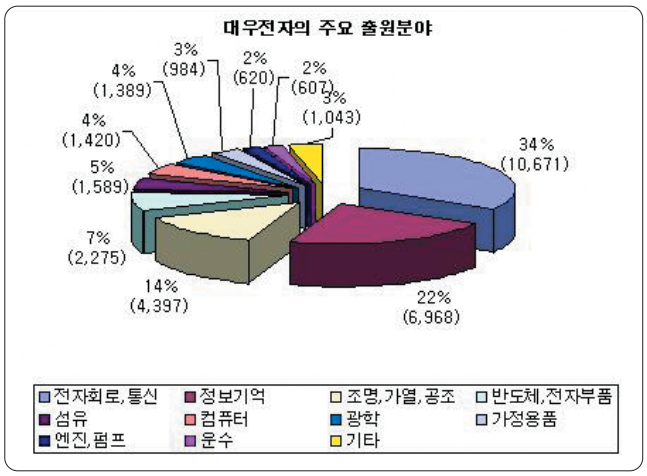


그림 19. 대우전자의 주요 출원분야

대우전자는 전체적으로 <그림 18>처럼 1994년 이후 출원량이 급격히 증가하였다가 1996년 이후 급격히 감소하는 부침이 심한 양상을 보였다. 출원분야에 있어서 전자회로, 통신분야가 대우전자 전체출원의 34%(10,671건)로 가장 높은 비중을 차지하였고, 정보기억(22%) 및 조명, 가열, 공조분야(14%) 순으로 출원이 있었다.

B 대우전자의 기술집중도(AI)

대우전자	82~84	85~89	90~94	95~99	AI 평균	AI 순위	점유율(국내출원)	AI(90년말~80년말)
가정용품	0.00	0.33	1.98	2.01	1.94	6	9.0%	1.68
정보기억	3.88	1.90	2.11	3.30	3.14	2	15.0%	1.40
전자회로, 통신	9.50	1.30	2.88	2.30	2.60	3	12.0%	1.00
엔진, 펌프	0.00	0.78	0.26	0.58	0.56	9	3.0%	−0.20
반도체, 전자부품	0.00	0.67	0.44	0.39	0.42	10	2.0%	−0.28
섬유	0.00	2.53	3.25	2.15	2.26	5	11.0%	−0.38
컴퓨터	0.00	1.31	1.16	0.77	0.86	7	4.0%	−0.54
조명, 가열, 공조	5.05	4.54	4.52	3.48	3.90	1	18.0%	−1.06
광학	0.00	2.85	0.47	0.77	0.74	8	3.0%	−2.08
무기, 폭발	0.00	53.50	3.43	2.19	2.59	4	12.0%	−51.31

그림 20. 대우전자의 AI

대우전자는 조명, 가열, 공조분야의 출원집중도가 가장 높았고 이 분야에서 엘지전자(4,413건)에 이어 4,397건을 출원을 하였다. 또한 정보기억분야에서 삼성전자의 10,643건 출원에 이어 6,968건을 출원하였다. <그림 20>에서 나타나듯이 90년대 말과 80년대 말의 AI 변동에 있어서 대우전자의 전체적인 출원의 감소로 인하여 출원집중도가 약해지고 있음을 보였다.

5) 현대자동차

A 현대자동차의 연도별 출원동향 및 출원분야

현대자동차는 <그림 20>에서와 같이 1995년 이후 출원이 가파르게 증가하고 있으며, 국내의 외환위기시기인 1997년 이후 출원이 급감하였다. 한편 <그림 22>에서 알 수 있듯이 현대자동차는 전체 출원건 중 46%가 운수(차량, 조선, 항공)분야에 집중되고 있으며, 엔진분야(20%)와 기계부품분야(15%)가 주요 출원 대상이었다.

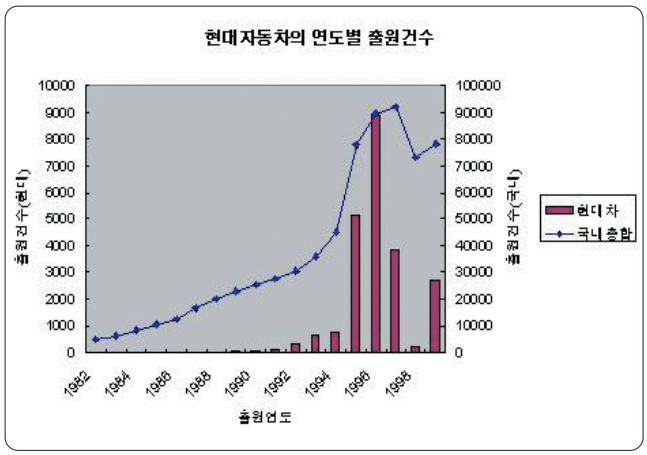


그림 21. 현대자동차의 연도별 출원동향

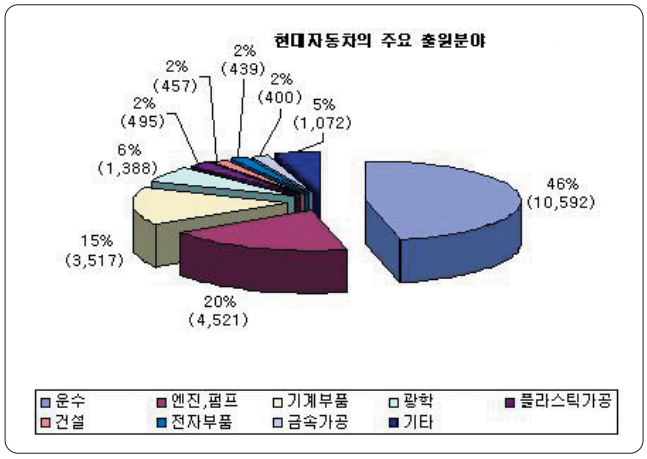


그림 22. 현대자동차의 주요 출원분야

B 현대자동차의 기술집중도(AI)

현대차	82~84	85~89	90~94	95~99	AI 평균	AI 순위	점유율(국내출원)	AI(90년말~80년말)
기계부품	0.00	3.64	5.36	5.75	6.19	2	21.0%	2.11
야금	0.00	0.00	0.70	0.39	0.37	8	1.0%	0.39
플라스틱가공	0.00	0.74	0.41	1.11	0.89	6	3.0%	0.37
건설	0.00	0.81	0.90	1.16	1.18	4	4.0%	0.35
석유화학	0.00	0.00	0.15	0.28	0.20	10	1.0%	0.28
광학	0.00	0.90	0.90	1.01	1.03	5	3.0%	0.11
고분자	0.00	0.25	0.21	0.29	0.21	9	1.0%	0.04
금속가공	0.00	0.93	1.62	0.86	0.84	7	3.0%	−0.07
엔진,펌프	0.00	9.16	9.08	4.92	5.70	3	19.0%	−4.24
운수	31.63	14.82	11.92	4.97	6.54	1	22.0%	−9.85

그림 23. 현대자동차의 AI

현대자동차는 <그림 22>와 같이 국내점유율에서 운수(차량, 조선, 항공)분야와 기계부품분야가 22%와 21%로 가장 높

았고, 운수(차량, 조선, 항공)분야는 10,592건을 출원하여 출원집중도(6.54)가 가장 높았고 기계부품분야(3,517건) 및 엔진펌프분야(4,521건)가 그 다음이었다. 그리고 엔진펌프분야에서는 현대자동차가 그 분야의 19.0%를 점유하며 가장 많은 출원을 하였다. 80년대 후반에 비하여 90년대 후반에 현대자동차는 기계부품의 출원집중도가 상대적으로 증가하였음을 알 수 있다.

C 기계부품분야에서의 현대자동차 및 주요 경쟁기업의 출원동향.

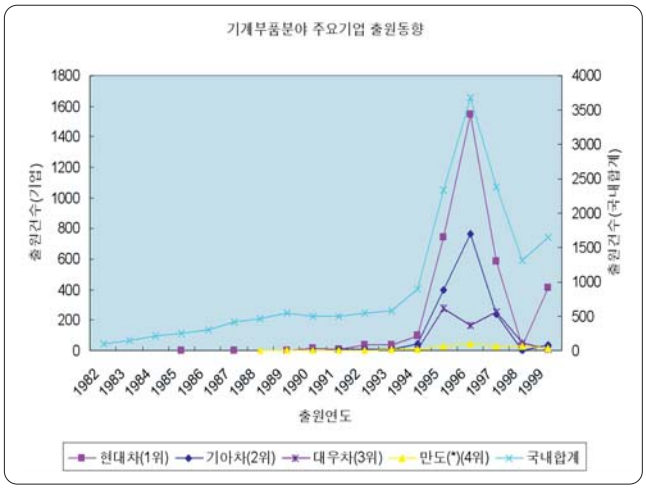


그림 24. 기계부품분야의 출원동향

기계부품분야에서는 현대자동차는 가장 많은 출원을 하였고 전체적으로 자동차 완성차 업계인 3개사(현대자동차, 기아자동차, 대우자동차)모두 1997년 이후 출원이 급감하였으며, 그 외에도 만도의 출원이 꾸준히 지속되고 있음을 알 수 있다.

6) 기아자동차

A 기아자동차의 연도별 출원동향 및 출원분야

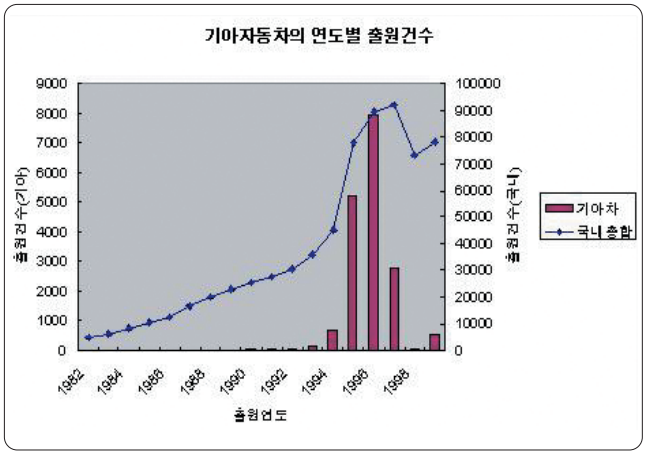


그림 25. 기아자동차의 연도별 출원동향

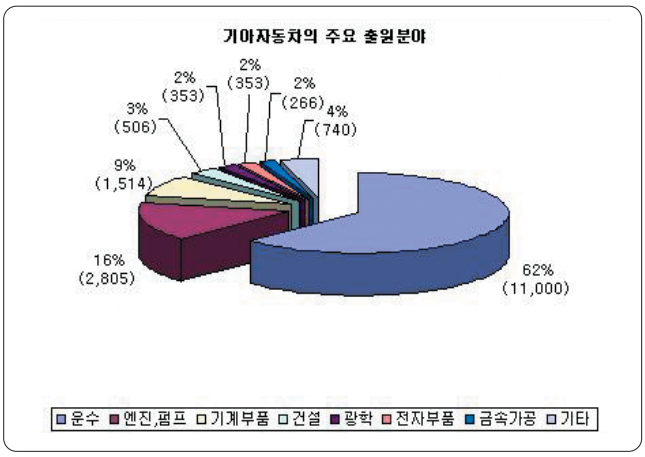


그림 26. 기아자동차의 주요 출원분야

기아자동차는 현대자동차와 매우 유사한 출원경향을 보이고 있으며, 운수(차량, 조선, 항공)분야에 대하여 출원비중이 62%(11,000건)에 이르러 국내에서 가장 많은 출원을 하였으며, 엔진분야(16%)와 기계부품(9%)분야를 그 다음으로 출원량이 많았다.

B 기아자동차의 기술집중도(AI)

기아차	82~84	85~89	90~94	95~99	AI 평균	AI 순위	점유율(국내출원)	AI(90년말~80년말)
엔진, 펌프	0.00	0.00	7.43	4.02	4.61	2	12.0%	4.02
기계부품	0.00	0.00	3.96	3.15	3.48	3	9.0%	3.15
건설	0.00	0.00	1.07	1.67	1.70	4	4.0%	1.67
플라스틱가공	0.00	0.00	0.55	0.42	0.37	6	1.0%	0.42
기타	0.00	0.00	0.00	0.34	0.28	8	1.0%	0.34
광학	0.00	0.00	0.31	0.33	0.34	7	1.0%	0.33
포장	0.00	0.00	0.43	0.26	0.25	9	1.0%	0.26
분리, 혼합	0.00	0.00	0.31	0.19	0.18	10	0.0%	0.19
운수	31.63	9.88	15.00	6.76	8.86	1	23.0%	−3.12
금속가공	0.00	12.42	1.24	0.79	0.73	5	2.0%	−11.63

그림 27. 기아자동차의 AI

기아자동차 역시 현대자동차와 마찬가지로 운수(차량, 조선, 항공)분야에 대한 국내출원점유율(23%)과 기술집중도(8.86)가 매우 높게 나타나고 있으며, AI에 있어서, 80년대 말에 비하여 90년대말에 엔진분야와 기계부품분야의 출원집중도가 높게 나타나 이 분야에서 상대적으로 많은 출원이 이루어졌음을 알 수 있다.

C 운수(차량, 조선, 항공)분야에 있어서 기아자동차 및 주요 경쟁기업의 출원동향.

운수(차량, 조선, 항공)의 주요기업의 출원경향을 보면 기아자동차는 1990년대 초반이후 출원이 되었음에도 불구하고 가장 많은 출원(11,000건)을 하였고, 현대자동차가 10,592건을 출원하였다. 또한 자동차 부품업체인 만도의 출원도 꾸준히 증가하여 대우자동차의 뒤를 이었다.

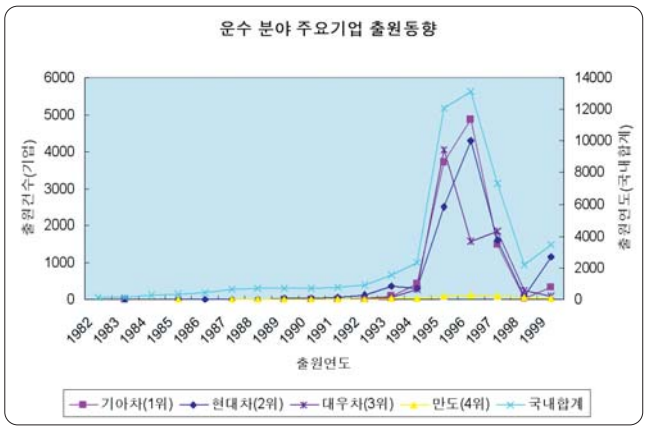


그림 28. 운수 분야 주요기업 출원동향

7) 대우자동차

A 대우자동차의 연도별 출원동향 및 출원분야

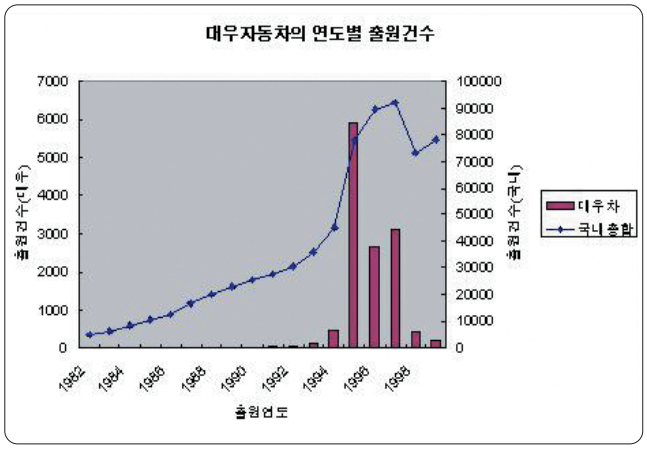


그림 29. 대우자동차의 연도별 출원동향

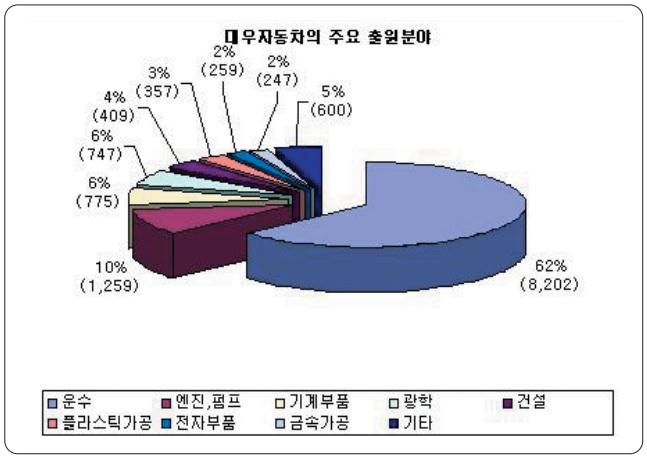


그림 30. 대우자동차의 주요 출원분야

<그림 28>에서보듯 대우자동차는 1994년 이후 출원이 많이 늘어났으며, 1996년 출원량의 감소후 1998년 이후 국내의 전체적 출원량은 다시 증가하고 있으나 대우자동차의 출원량은 줄어들고 있으며 현대자동차 및 기아자동차와 마찬가지로 운수(차량, 조선, 항공)분야의 출원이 62%(8,202건)로 가장 많고 엔진. 펌프(10%, 1,259건) 및 기계부품관련 분야(6%, 775건)등의 기술분야가 다음으로 많이 출원되었다.

B 대우자동차의 기술집중도(AI)

대우차	82~84	85~89	90~94	95~99	AI 평균	AI 순위	점유율(국내출원)	AI(90년말~80년말)
엔진, 펌프	–	0.00	5.79	2.40	2.81	2	5.0%	2.40
기계부품	–	0.00	1.84	2.22	2.41	3	5.0%	2.22
건설	–	0.00	2.14	2.15	2.23	4	4.0%	2.15
플라스틱가공	–	0.00	0.50	1.39	1.14	5	2.0%	1.39
금속가공	–	0.00	0.54	1.07	0.91	7	2.0%	1.07
광학	–	0.00	0.85	0.96	0.98	6	2.0%	0.96
포장	–	0.00	0.16	0.54	0.46	8	1.0%	0.54
분리, 혼합	–	0.00	0.16	0.47	0.42	9	1.0%	0.47
컴퓨터	–	0.00	0.23	0.15	0.15	10	0.0%	0.15
운수	–	29.65	15.55	6.82	8.95	1	17.0%	–22.83

그림 31. 대우자동차의 AI

1990년 이전에는 운수(차량, 조선, 항공)분야에 대한 출원이 대부분이었고 점차 다변화되어 갔으며, 90년대 후반에 이르러서는 엔진분야(2.40)와 기계부품(2.22) 및 건설분야(2.15)에 대한 집중도가 증가하였다.

8) ETRI

A ETRI의 연도별 출원동향 및 출원분포.

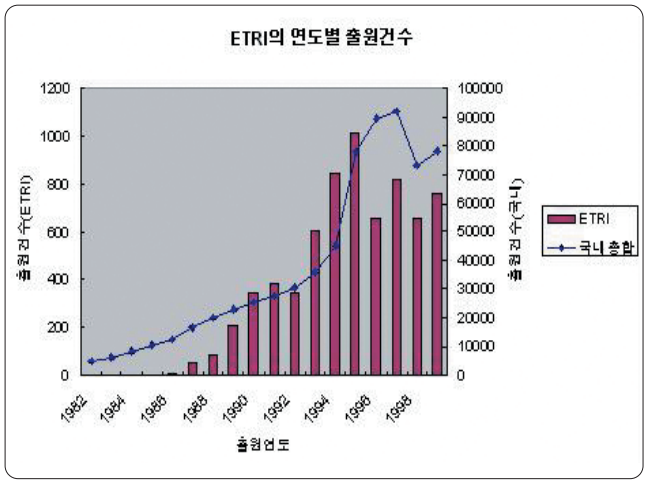


그림 32. ETRI의 연도별 출원동향

1980년대 후반 이후 ETRI의 출원은 꾸준히 증가해 가고 있으며, 출원분야에 있어서 전자회로, 통신분야가 ETRI 전체출원의 52%를 점유하며 가장 많은 3,526건을 출원하였고, 컴퓨터분야가 20%(1,337건) 그리고 반도체, 전자부품분야가 19%를 점유하며 1,312건을 각각 출원하였다.

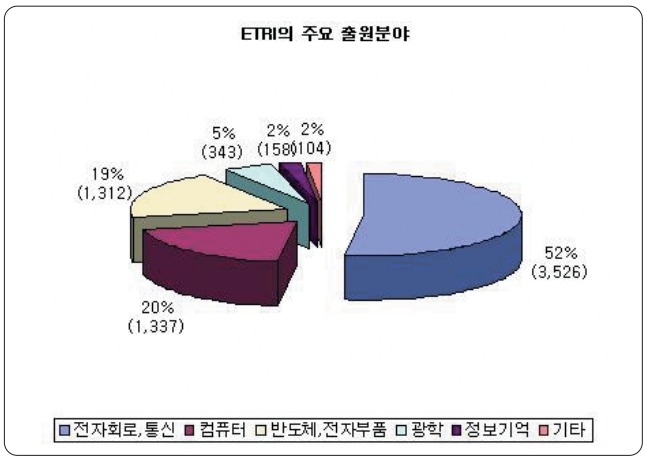


그림 33. ETRI의 주요 출원분야

B ETRI의 기술집중도(AI)

ETRI	82~84	85~89	90~94	95~99	AI 평균	AI 순위	점유율(국내출원)	AI(90년말~80년말)
광학	–	0.31	0.73	0.97	0.86	4	1.0%	0.66
무기, 폭발	–	0.00	0.00	0.22	0.09	8	0.0%	0.22
무기화학	–	0.00	0.26	0.07	0.15	6	0.0%	0.07
원자력	–	0.00	0.00	0.00	0.06	10	0.0%	0.00
야금	–	0.12	0.10	0.11	0.10	7	0.0%	– 0.01
의료기기	–	0.14	0.02	0.13	0.09	9	0.0%	– 0.01
컴퓨터	–	4.45	2.93	4.28	3.82	2	4.0%	– 0.17
정보기억	–	0.55	0.23	0.37	0.34	5	0.0%	– 0.18
반도체, 전자부품	–	1.77	1.32	0.97	1.15	3	1.0%	– 0.80
전자회로, 통신	–	5.99	4.41	3.50	4.04	1	4.0%	– 2.49

그림 34. ETRI의 AI

ETRI의 국내출원 점유율은 각각 4%를 점유하며 전자회로, 통신분야(4.04)와 컴퓨터분야(3.82)에서 높은 출원 집중도를 보이고 있으며, 1990년대 후반에는 광학분야(G01~G03)에 집중도가 증가하며 국내의 점유율도 1%로 성장하였다.

9) 포항제철

A 포항제철의 연도별 출원동향 및 출원분야

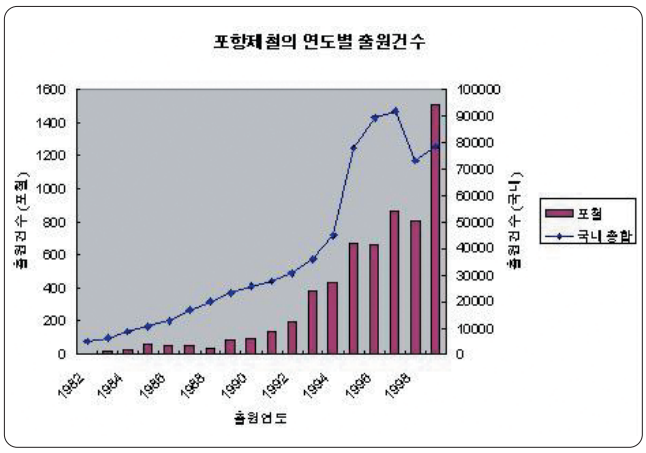


그림 35. 포항제철의 연도별 출원동향

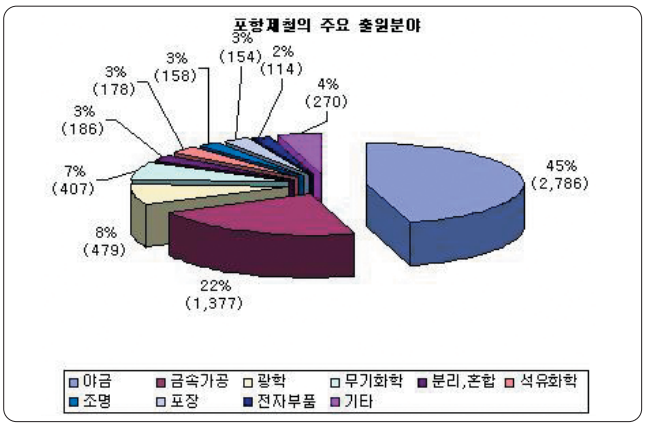


그림 36. 포항제철의 주요 출원분야

<그림 35>와 <그림 36>에서 알 수 있듯이 포항제철은 출원건수의 변동이 다른 주요출원기업과 비교하여 상대적으로 변화가 심하지 않으며 점차 증가하는 양상을 보이고 있다. 주요 출원분야는 야금분야(C21~C23,C25,C30)가 포항제철 전체출원의 45%(2,786건)를 차지하며 금속가공과 광학분야가 각각 22%와 8%를 점유하였다.

B 포항제철의 기술집중도(AI)

포철	82~84	85~89	90~94	95~99	AI 평균	AI 순위	점유율(국내출원)	AI(90년말~80년말)
금속가공	3.19	2.75	7.60	13.74	10.80	2	10.0%	10.99
야금	22.26	25.28	25.37	29.96	26.32	1	24.0%	4.68
포장	0.00	0.00	0.13	2.24	1.51	6	1.0%	2.24
석유화학	0.00	1.47	1.00	2.20	1.56	5	1.0%	0.73
분리, 혼합	0.00	1.38	0.97	1.92	1.60	4	1.0%	0.54
조명	0.00	0.30	0.25	0.83	0.73	8	1.0%	0.53
플라스틱가공	0.00	0.00	0.35	0.46	0.37	9	0.0%	0.46
고분자	0.00	0.07	0.08	0.40	0.23	10	0.0%	0.33
광학	1.57	1.21	1.42	1.28	1.33	7	1.0%	0.07
무기화학	1.97	3.77	4.80	2.77	3.12	3	3.0%	–1.00

그림 37. 포항제철의 AI

포항제철은 야금분야에서 국내 전체 출원의 24%를 점유하며 포항제철의 출원집중도에서도 가장 높은 지수를 나타냈으며, 금속가공(B21~B23)과 무기화학분야C01~C05)의 출원집중도가 그 뒤를 잇고 있다. 또한 90년대말과 80년대말의 집중도의 변화를 보면, 금속가공분야와 야금분야의 출원이 상대적으로 늘어나고 있음을 알 수 있고, 무기화학분야가 상대적 집중도가 약함을 보이고 있다.

C 금속가공분야에서의 포항제철 및 주요 경쟁기업의 출원동향

포항제철에서 90년대 후반 상대적 출원집중도가 높았던 금속가공분야의 주요기업의 출원동향을 살펴보면, <그림 38>에서와 같이 현대자동차와 대우중공업이 많은 출원을 하고 있으며, 포항제철은 지속적인 출원 증가를 보였다. 또한 현대자동차와 대우중공업의 금속가공분야에 대한 출원은 1998년 잠시 감소하였으나 다시 증가추세에 있다.

그림 38. 금속분야의 주요기업의 출원동향

10) 삼성SDI

A 삼성SDI의 연도별 출원동향 및 출원분야

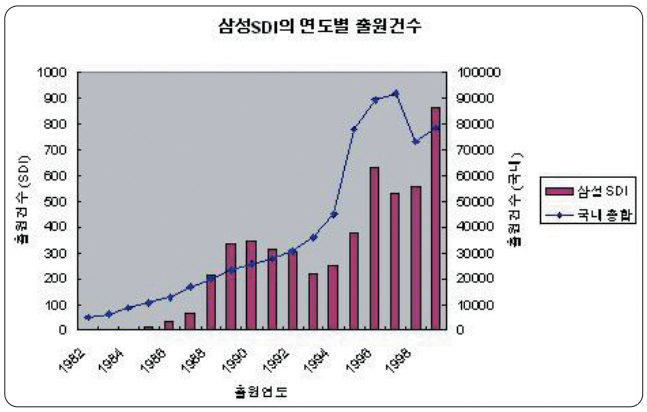


그림 39. 삼성SDI의 연도별 출원동향

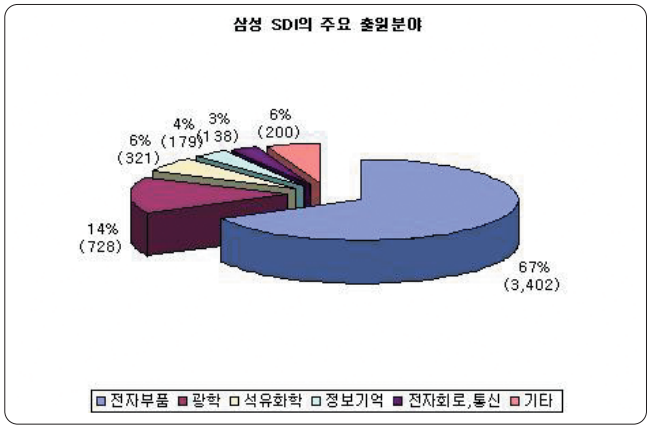


그림 40. 삼성SDI의 주요 출원분야

<그림 39>와 <그림 40>에서 삼성SDI의 출원은 계속적인 성장 흐름 속에서 93년과 94년의 출원감소 이후 다시 증가하고 있으며, 삼성SDI의 전체 출원중 반도체, 전자부품분야의 출원이 67%를 차지하며 가장 많은 비중을 차지하고 있으며, 광학분야에서 728건을 출원하여 14%의 비중을 차지하고 있다.

B 삼성SDI의 기술집중도(AI)

삼성SDI	82~84	85~89	90~94	95~99	AI 평균	AI 순위	점유율(국내출원)	AI(90년말~80년말)
기타	0.00	0.00	0.00	0.63	0.32	6	0.0%	0.63
정보기억	0.00	0.17	0.56	0.55	0.51	4	0.0%	0.38
금속가공	0.00	0.17	0.18	0.37	0.28	7	0.0%	0.20
무기화학	0.00	0.27	0.11	0.34	0.25	9	0.0%	0.07
광학	0.00	2.13	3.16	2.16	2.45	3	2.0%	0.03
분리, 혼합	0.00	0.40	0.21	0.38	0.33	5	0.0%	−0.02
컴퓨터	6.82	0.24	0.38	0.20	0.26	8	0.0%	−0.04
전자회로, 통신	0.00	0.30	0.25	0.18	0.21	10	0.0%	−0.12
반도체, 전자부품	5.75	5.01	3.72	3.90	3.99	1	3.0%	−1.11
석유화학	0.00	4.90	3.78	2.37	3.41	2	3.0%	−2.53

그림 41. 삼성SDI의 AI

삼성SDI는 반도체. 전자부품(H01,H02,H05)분야, 석유화학(C09~C11)분야 및 광학분야(G01~G03)출원집중도가 높았으며, 90년대 후반에는 정보기억분야와 금속가공분야의 출원집중도가 증가하고 있음을 보인다.

Ⅲ. 결 론

이상에서 국내특허출원 다출원인 10개 단체의 출원경향, 출원분야 및 출원 집중도에 대하여 알아보았다. 국내에서 가장 많은 출원을 하였던 삼성전자와 엘지전자는 비교적 여러 분야에서 출원이 이루어지고 있고 최근 반도체, 전자부품분야 및 전자회로, 통신분야에서 더욱 많은 출원이 이루어지고 있음을 알 수 있었고, 하이닉스는 반도체분야와 정보기억분야쪽으로 출원이 많았으며, 대우전자는 상대적으로 1996년 이후 전체적으로 출원이 많이 줄어들고 있었다. 또한 ETRI는 전자회로, 통신분야에 집중적인 출원이 이루어지고 있음을 보였다. 한편 국내의 주요 완성차 업체인 현대자동차는 차량, 조선, 항공분야 및 관련 기계부품과 엔진분야에 비교적 많은 출원이 있었던 반면 기아자동차와 대우자동차는 상대적으로 기계부품과 엔진분야의 출원이 적었다. 포항제철은 출원의 감소 없이 꾸준히 증가하여 안정적인 출원을 하였다. 1997년 말 국내경제의 외환위기상황에서 국내의 전체적인 출원감소가 두드러졌으며, 특히 기계. 자동차. 금속. 화학업군에 분류되었던 현대자동차, 기아자동차, 대우자동차의 출원감소가 상대적으로 두드러져 경제위기의 영향을 많이 받았던 것으로 분석된다.

마지막으로 본 보고서에서는 다루지 못하였던 좀더 자세한 기술적 분류와 각 기업체의 연구투자관련 정보 및 사업정보를 접목한다면 특허출원과 기업의 향후 집중분야를 예측하고 경제에 미치는 영향 등을 분석할 수 있을 것이라 여겨지며, 이는 차후 좀더 많은 연구를 통하여 보충 될 수 있으리라 사료된다.

한국내 독일의 특허활동

조사분석2팀 박홍규
조사분석4팀 한동희

1. 개요

과학기술이 미래의 경제에 영향을 미칠것이라는 것은 자명한 사실이다. 미국, 일본, 유럽 등의 국가들은 미래주도적인 기술을 발전시키고, 그 전제사항으로 R&D에 관한 투자효율성을 높이기 위해 다양한 지표를 사용하여 연구하고 있다. 본 보고서에서는 특허라는 객관적이고 표준화된 정보를 사용하여 한국내의 독일의 특허출원에 관해 분석하였다.

2001년 12월 31일까지의 국내 공개특허 771,760건 중 출원일 기준 1999년 12월 31일까지의 국내의 모든 독일특허를 분석하였으며 국내 특허공개공보에 명시된 제1출원인(국적, 출원인 명칭, 주소지 등)을 분석대상으로 하였다. 그리고 기술분야별 적용은 WIPO 기준 32개 기술분야 (IPC 6판)을 적용하였다. IPC는 기능, 용도, 방법 등으로 분류되고 5년마다 개정되어 미국특허분류나 일본FI에 비해 다각적인 관점에서는 분류하기 어렵다고 판단되나 전체적 분류에 있어서 가치가 있다고 판단되어 활용하였다.

2. 한국 내 독일의 출원동향

그림1에서 보는 바와 같이 1999년까지 국내에 출원 공개된 686,343건 중 독일은 4%(24,495)를 차지하고 있다. 한국내의 외국인출원에서 일본(JP)이 116,928건으로 17%를 차지하고 있으며, 미국(US)이 82,263건으로 12%, 그 뒤를 이어 독일이 출원하고 있음을 알 수 있다.

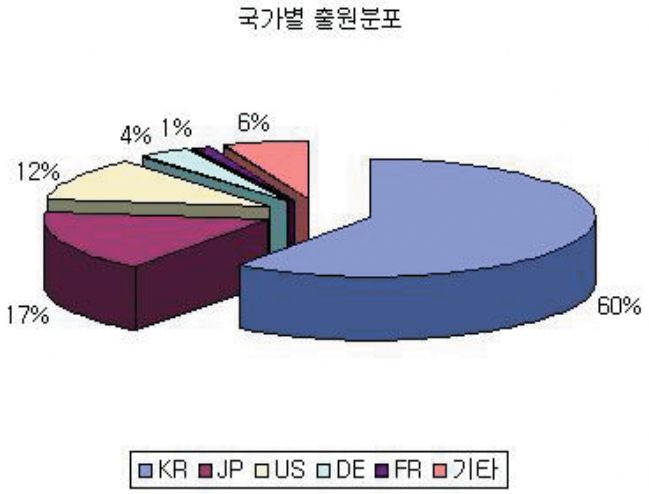


그림 1. 한국내 국가별 출원분포

2-1. 연도별 출원동향

그림2에서 보는 바와 같이 국내에서 최근 10년간 꾸준한 증가세를 보이고 있는 독일출원은 1999년에는 2,614건에 달하고 있다. 1999년에 들어서 약간 주춤하는 현상을 보이고 있으며 이는 독일에서 한국시장을 인식하고 있는 수준을 그대로 반영한 것으로 보인다. 그리고 우리나라에 사업진출 가능성 및 기술거래의 향상, 특허를 통한 경쟁력 우위를 점유하고 다국적기업의 공동연구가 증가된 것으로 보여지고 있다.

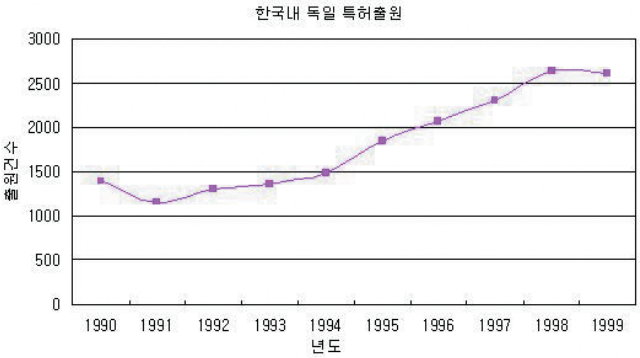


그림 2. 연도별 한국내 독일특허출원

그림3은 한국내 독일의 다출원 상위 5개 기업의 연도별 출원동향을 보인 것이다. 다출원 상위 5개사는 화학 및 운수분야에 집중하여 한국내 독일출원을 39% 점유하고 있으므로 그 의미가 크다. 다출원 상위 5개사의 출원경향에 대해서는 뒤에 자세히 서술하였으며 여기에서는 연도별 출원경향에 대해서만 언급하였다. 상위 5개사는 1980년대 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으나, 90년대 전반에 감소, 중반에 다시 증가하는 추세를 보이고 있다. 이것은 본 보고서에는 나타나 있지 않으나 미국기업의 한국특허출원에서도 나타나는 현상으로 이러한 감소추이는 외국인의 출원정책 변화와 국내 특허법 개정에 의한 영향으로 추측되어진다. 그리고 90년대 후반에는 다시 감소추세를 보이는데 그림2에서와 같이 독일 전체 출원이 증가하는 것은 상위 5개사에 해당하지 않는 INFINEON TECHNOLOGIES가 2000년대에 집중출원을 하였기 때문이다. 특히 HOECHST사는 1980년대 후반과 1990년대 초반에 정점에 이른 후 감소하는 특징을 보이고 있는데, 이것은 HOECHST사가 프랑스의 론풀랑크와 합병되어 아벤티스그룹으로 변경되었기 때문으로 해석되어지며, SIEMENS사가 1995년 이후 출원이 급격히 증가하는 것은 IT산업의 발달로 인하여 연구개발이 활발해진 것으로 보여진다.

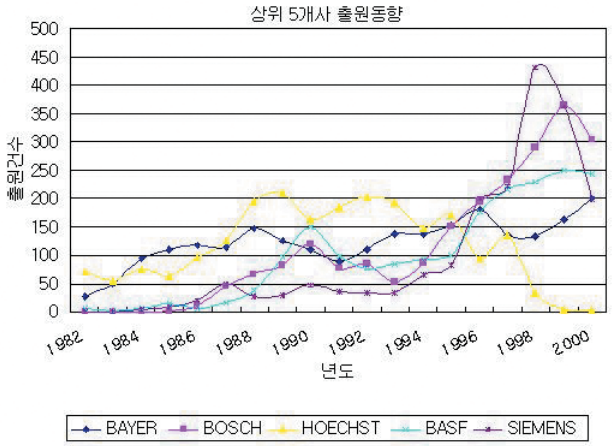


그림 3. 다출원 상위 5개사의 연도별 특허출원동향

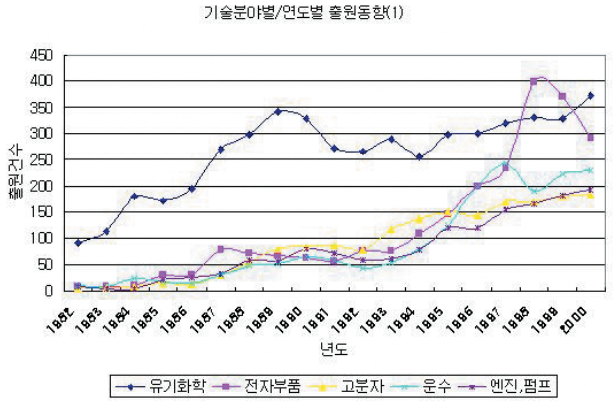


그림 4. 한국내 독일출원의 기술분야별/연도별 출원동향(1)

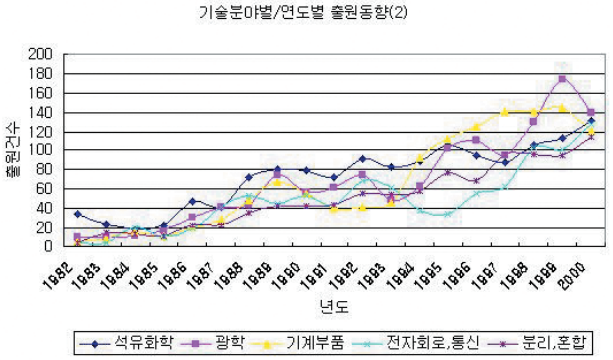


그림 5. 한국내 독일출원의 기술분야별/연도별 출원동향(2)

그림4, 5는 상위 10개 기술분야의 연도별 출원추이를 나타낸 것이다. 매년 유기화학분야의 출원이 많은 것을 알 수 있다. 그림 4에서 보듯이 1990년대 중반까지 유기화학분야의 출원이 많다가 1990년대 후반에 전자부품의 출원이 유기화학분야의 출원을 앞지르고 있다. 이것은 세계적으로 정보통신의 발전과 더불어 전자부품의 특허출원이 증가하는 것을 나타내 주는 자료이다. 그러나 2000년에 유기화학분야의 출원이 다시 앞지르는 것은 전통적으로 유기화학의 고부가가치 핵심기술을 독일이 가지고 있기 때문으로 보여지며 중국 및 아시아시장에 화학제품을 조달하기 위해 출원을 증가하는 것도 하나의 이유이다.

2-2. 기술별 출원동향

그림6에서 보는 바와 같이 국내의 총출원 누적건수에 대한 기술분야별 출원분포를 보면 화학(36%), 운수(19%), 전기(13%), 기계(12%), 물리(10%)등의 순서를 보이고 있다. 여기에서 보는 바와 같이 화학과 운수분야가 전체의 55%를 차지하고 있어 화학과 자동차 분야에서 많은 연구 및 출원을 하고 있음을 알 수 있다.

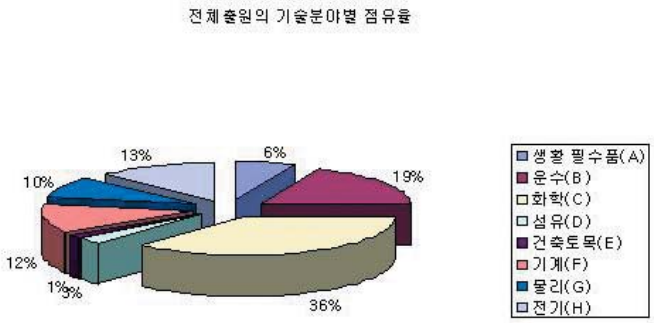


그림 6. 한국내 독일의 전체출원의 기술분야별 점유율

그림7은 다출원 상위 5개 기업의 기술분야별 점유비율을 나타낸 것이다. BAYER, HOECHST, BASF사는 화학에, BOSCH사는 운수, 기계 등에, SIEMENS사는 물리, 전기분야에 집중하여 출원하는 것으로 나타났다. 상위 5개사 중에서 3개사가 화학분야에 집중해서 출원하고 있는 것은 주목할 만하다. 이것은 독일화학기업이 한국내 독일출원을 주도하는 것으로 판단되어지며 우리나라 기업의 전자관련 출원이 급증하고 있는 것과 비교해 볼때 대조적이라 할 수 있다. 그리고 독일의 화학분야 출원건은 응용기술이 많아 이 부분에 좀 더 관심을 가지고 특허분석을 해야 할 것으로 판단된다.

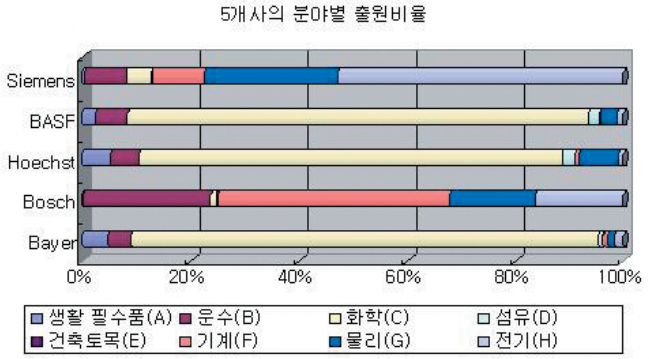


그림 7. 다출원 상위 5개 기업의 기술분야별 출원점유율

표1은 기술별 분야별 특허활동지수(AI)를 나타낸 것으로 80년대 후반과 90년대 후반의 AI를 비교해 보면 90년대 후반에 국내특허활동지수가 높아진 분야는 고분자, 광학, 기계부품, 엔진펌프, 운수, 전자부품, 컴퓨터 분야이고, 반대로 낮아진 분야는 가정용품, 건설, 유기화학 등의 분야임을 알 수 있다.

32개분야	82~84년도	85~89년도	90~94년도	95~99년도	평균
가정용품	1.61	1.62	0.82	0.77	1.21
건설	1.01	1.04	0.95	0.97	0.99
고분자	0.34	0.65	1.20	1.13	0.83
광업	0.94	1.35	1.32	0.68	1.07
광학	0.62	0.92	0.96	1.12	0.91
금속가공	0.70	1.16	1.03	0.96	0.96
기계부품	0.57	0.79	0.88	1.23	0.87
기타	0.00	0.40	0.56	1.64	0.65
농수산	2.39	0.26	0.62	1.37	1.16
무기, 폭발	2.14	1.01	1.48	0.66	1.32
무기화학	0.62	0.85	1.21	0.97	0.91
바이오	0.77	1.49	1.08	0.78	1.03
분리,혼합	0.84	0.80	1.08	1.07	0.95
석유화학	1.38	1.05	1.17	0.83	1.11
섬유	1.93	1.10	1.13	0.76	1.23
식료품	1.34	1.33	0.99	0.85	1.13
야금	0.96	1.06	1.03	0.97	1.01
엔진,펌프	0.30	0.75	0.95	1.19	0.80
운수	0.67	0.56	0.73	1.39	0.84
원자력	1.94	2.04	0.67	0.63	1.32
유기화학	1.86	1.35	1.06	0.69	1.24
의료기기	1.85	0.97	0.96	0.99	1.19
의약	1.45	1.11	1.02	0.91	1.12
인쇄	1.69	0.99	1.00	0.96	1.16
전자부품	0.33	0.69	0.68	1.40	0.78
전자회로,통신	0.76	1.05	1.17	0.92	0.97
정보기억	0.56	1.45	1.22	0.76	1.00
조명	1.26	0.98	0.76	1.09	1.03
종이	0.77	1.08	0.89	0.91	0.91
컴퓨터	0.45	0.62	0.66	1.42	0.79
포장	0.77	0.91	1.22	0.93	0.96
플라스틱가공	0.59	1.05	10.6	1.01	0.93

표 1. 기술분야별 특허활동지수 (AI)

2-3. 다출원 상위5개사 분야별 출원동향

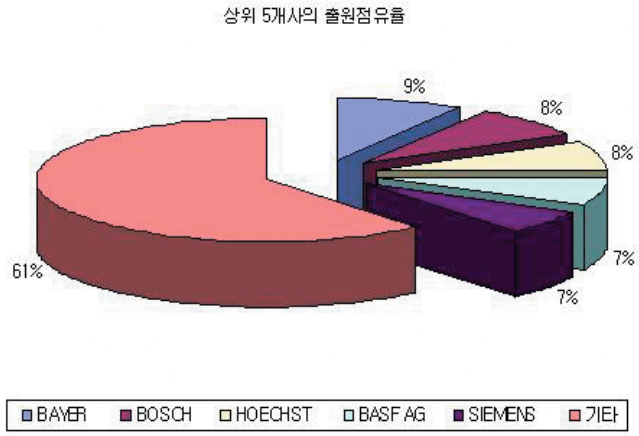


그림 8. 한국내 독일출원의 상위5개사의 출원점유율

그림8은 다출원 상위 5개 기업의 특허출원점유율을 나타낸 것으로 BAYER이 최다 출원기업으로 전체출원의 9%정도를 차지하고 있으며 그림3에서 보는 바와 같이 BAYER의 최근 출원도 증가하고 있다. BOSCH와 HOECHST사가 각각 8% 정도를 차지하고 BASF와 SIEMENS사가 7%출원을 보이고 있다. 5대 기업을 제외한 다른 기업과 개인출원비율은 61%이다.

2-3-1. BAYER의 특허활동

전통적으로 세계적인 다국적 기업인 BAYER사는 유기화학를 비롯한 화학분야에 많은 출원을 하고 있다. 그림9는 BAYER사의 한국내 100건이상(총출원 누적합계) 출원분야를 보이고 있다. 보이는 바와 같이 유기화학분야에서 1980년대 후반이후 출원활동이 두드러진다. 4개의 카테고리인 유기화학, 고분자, 석유화학, 의약 분야에 100건 이상의 특허출원을 하고 있다. BAYER사는 최근 구조조정을 통하여 고분자 및 의약품 등의 고부가가치 산업의 수요에 대응하고 가격경쟁력도 우위를 확보한다는 전략을 구사하여 이 분야의 출원이 증가할 것으로 예상된다.

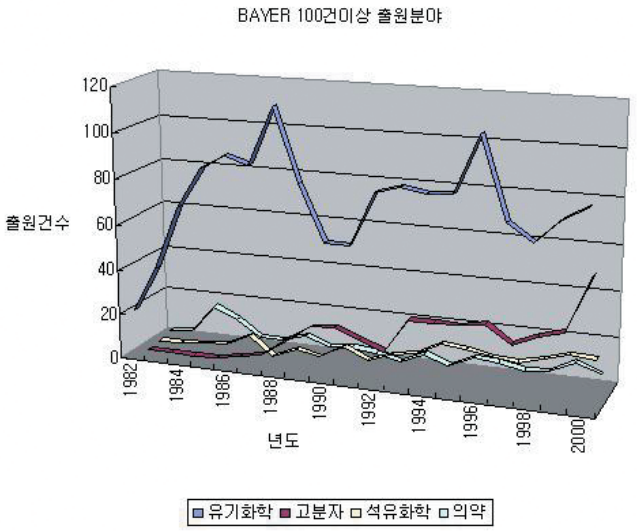


그림 9. 한국내 독일출원중 BAYER의 100건 이상 출원기술의 연도별 동향

2-3-2. BOSCH의 특허활동

그림10은 BOSCH사의 한국내 100건 이상(총출원 누적합계) 출원분야를 보이고 있다. 5개의 카테고리인 엔진·펌프, 운수, 전자부품, 광학, 기계부품 분야에 100건 이상의 특허출원을 하고 있다. 1994년에 대부분의 카테고리에서 출원수가 감소하다 증가하는 경향을 보이고 있다. 엔진·펌프분야의 출원량이 상대적으로 많으며 1990년 후반에는 운수분야의 출원량이 증가하는 것이 두드러진다. 운수, 전자부품, 광학 등은 비슷한 출원량의 분포를 나타내며 증가하고 있다.

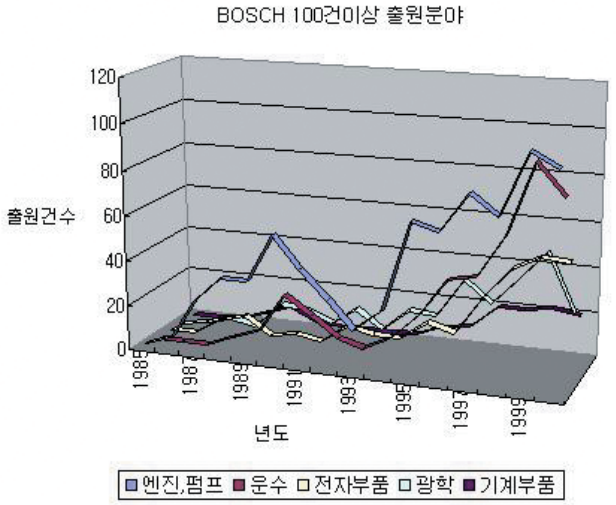


그림 10. 한국내 독일출원중 BOSCH의 100건 이상 출원기술의 연도별 동향

2-3-3. HOECHST의 특허활동

그림11은 HOECHST사의 한국내 100건이상(총출원 누적합계) 출원분야를 보이고 있다. 6개의 카테고리인 유기화학, 고분자, 석유화학, 광학, 의약, 바이오 분야에 100건 이상의 특허출원을 하고 있다. 특이한 점은 출원양이 상대적으로 월등히 많은 유기화학분야가 1980년대 중반이후 급격히 증가하다가 1990년대 중반부터 급격히 감소하는 것을 보이는 것이 특징이다. 그러나 분석하는 과정에서 기술의 복합성으로 인해 구분(유기화학과 고분자 및 석유화학과 같은 특별한 공정으로 구분)하기 어려운 경우가 있어 일부 노이즈가 있을 가능성을 배제할 수는 없고, 앞에서 언급한 것처럼 HOECHST사가 프랑스의 론풀랑크와 합병되어 Aventis그룹으로 변경되었기 때문으로 보여지고 있다.

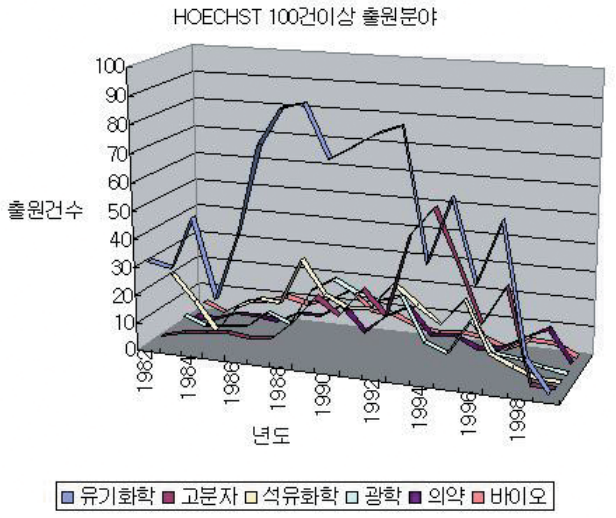


그림 11. 한국내 독일출원중 HOECHST의 100건이상 출원기술의 연도별 동향

2-3-4. BASF의 특허활동

그림12는 BASF사의 한국내 100건이상(총출원 누적합계) 출원분야를 보이고 있다. 3개의 카테고리인 유기화학, 고분자, 석유화학 분야에 100건 이상의 특허출원을 하고 있다. 3개의 카테고리에서 고른 출원을 보이고 있으며 수백여 가지의 기초원료 물질, 기초화학제품 및 중간체 등에 관한 R&D가 활발하게 이루어지는 것으로 보인다. 유기화학분야에서 1980년 후반에 급격히 증가하다가 1990년 초에 급격히 감소하는 것을 볼 수 있는데 이것은 한국내 독일의 특허출원현황과도 일치한다.

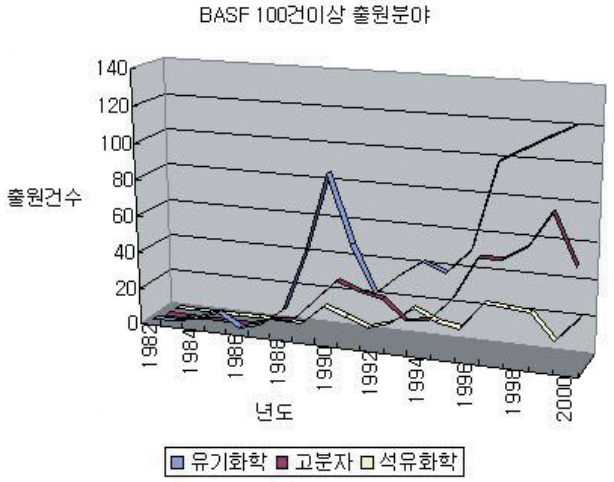


그림 12. 한국내 독일출원중 BASF의 100건 이상 출원기술의 연도별 동향

2-3-5. SIEMENS의 특허활동

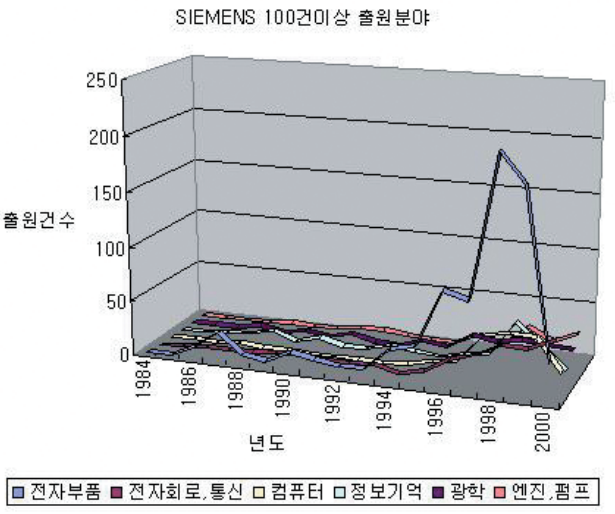


그림 13. 한국내 독일출원중 SIEMENS의 100건 이상 출원기술의 연도별 동향

그림13은 SIEMENS사의 한국내 100건 이상(총출원 누적합계) 출원분야를 보이고 있다. 6개의 카테고리인 전자부품, 전자회로·통신, 컴퓨터, 정보기억, 광학, 엔진·펌프 분야에 100건 이상의 출원을 보이고 있다. 전자부품에서 1990년대 이후 출원이 증가하다가 1990년 후반 감소하는 것을 볼 수 있다. 이것은 1990년대 초에 세계적으로 IT분야에 대한 R&D가 증가하는 것과 무관하지 않아 보인다. 전자회로·통신, 컴퓨터, 정보기억, 광학 및 엔진·펌프의 출원량은 비슷한 경향을 보이며 증가하고 있다.

2-3-6. 다출원 상위 5개사의 기술분야별 특허활동지수(AI)

표2는 다출원 5개 기업의 분야별 특허활동지수(AI)를 나타낸 것으로 BAYER 사는 유기화학과 고분자 분야에 집중되고 있고 BOSCH 사는 엔진펌프에 집중하고 있음을 알 수 있다. HOECHST 사는 고분자, 석유화학, 유기화학에, BASF 사는 고분자와 유기화학에 집중하는 것을 알 수 있다. SIEMENS 사는 원자력에서 높은 집중도를 보이고 있으며 전자부품과 컴퓨터도 높은 것으로 나타나고 있다.

32개분야	Bayer	Bosch	Hoechst	BASF	Siemens
가정용품	0.04	0.00	0.00	0.04	0.05
건설	0.04	0.45	0.04	0.00	0.09
고분자	2.34	0.01	2.22	3.72	0.18
광업	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
광학	0.19	2.56	1.46	0.38	1.32
금속가공	0.02	0.23	0.00	0.05	0.43
기계부품	0.10	1.36	0.01	0.02	0.29
기타	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
농수산	0.35	0.00	0.59	0.66	0.23
무기, 폭발	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
무기화학	0.69	0.25	1.14	0.83	0.14
바이오	0.56	0.00	2.19	0.90	0.03
분리,혼합	0.64	0.13	0.58	1.18	0.59
석유화학	1.18	0.00	2.41	1.57	0.16
섬유	0.38	0.00	1.05	0.52	0.00
식료품	0.97	0.15	0.61	0.68	0.00
야금	0.40	0.18	0.33	0.32	1.02
엔진,펌프	0.03	6.24	0.07	0.00	1.06
운수	0.07	3.23	0.03	0.02	0.54
원자력	0.00	0.00	0.11	0.00	7.22
유기화학	3.27	0.00	2.33	2.59	0.00
의료기기	0.18	0.06	0.17	0.19	0.17
의약	1.17	0.00	1.35	0.52	0.00
인쇄	0.17	0.00	0.83	0.31	0.22
전자부품	0.16	1.41	0.08	0.10	4.48
전자회로,통신	0.00	1.01	0.02	0.03	3.43
정보기억	0.14	0.20	0.09	0.56	2.93
조명	0.14	0.99	0.15	0.09	2.03
종이	0.22	0.00	0.00	1.63	0.14
컴퓨터	0.08	1.57	0.05	0.00	4.35
포장	0.05	0.39	0.39	0.09	0.25
플라스틱가공	0.50	0.34	0.61	0.46	0.07

표 2. 다출원 상위 5개 기업의 기술분야별 특허활동지수 (AI)

3. 결론

국내에 출원한 독일국적의 특허동향을 출원인별, 기술분야별로 분석하여 보았다. 분석에 의해 다음과 같은 점을 찾을 수 있었다.

첫째, 절대적인 특허 출원 건수에 있어서 본격적으로 출원이 이루어지는 시기는 1980년대 이후로 기술분야별 점유율을 보면 화학과 관련된 유기화학 및 고분자 기술에 관한 특허가 많았으며 출원기업중에도 BAYER, BASF, HOECHST 등 화학관련 회사들이 다수 있었다. 이는 전통적으로 화학강국인 독일의 산업구조와 밀접한 관련이 있다.

둘째, 기술분야별 출원현황으로 보았을때 독일은 한국내에 섬유, 건축·토목이 취약한 반면 화학분야가 상대적으로 점유율이 높았다. 이는 기초연구부터 제품의 생산까지 오랜 시간과 막대한 연구비가 소요되는 화학분야에 대한 정부나 민간의 투자가 활성화 되어 있음을 의미하는 증거이며 우리나라와는 강점을 가지는 기술분야, 관심을 집중하고 있는 기술분야가 다름을 의미한다.

셋째, 출원인 분포에서 주요 출원인은 기업이며 특별히 다출원 상위 5개 기업이 특허출원에서 차지하는 비중은 40%에 이르고 있다. 이는 BAYER, BOSCH, BASF, HOECHST, SIEMENS 등 상위기업이 한국내 독일출원을 선도한다는 의미를 가진다고 할 수 있으며, 각 사의 매출규모의 확대에 따라 특허분쟁의 소지가 있으므로 우리가 경계해야 할 대상으로 생각되어진다.

넷째, 특허출원인의 성격을 비교해 보면 국내의 독일특허는 다국적기업이 상대적으로 높게 나타나고 있다. 이는 다국적 기업의 원천기술에 대한 특허 확보 의지가 높음을 의미하기도 하지만 변화하는 산업사회에서의 기업의 특허전략을 보여주는 예라 할 수 있다.

지금까지 한국내 독일의 특허출원을 살펴보며 분석결과에서 보듯 선택과 집중을 통한 전략적인 기술개발이 요구됨을 알 수 있다. 독일의 경우 유기화학과 고분자 등 화학분야 전반에 연구를 활발히 하는 경향을 보이지만, 제한된 인적, 물적 자원을 가지고 있는 우리의 현실에서 경쟁력있는 분야에 대한 투자가 필요함을 알 수 있다.

실용신안 기술 평가의 정정청구 제도

1. 정정청구제도의 성격

- 기술평가 과정에서의 정정청구제도는 등록취소이유가 통지된 경우에, 설정등록시의 명세서 또는 도면을 정정할 수 있게 하여 등록취소이유를 해소할 수 있는 기회를 부여하는 제도이다.
- 정정이 인정된 후 유지결정된 청구항의 권리는 등록당시로 소급되므로 정정으로 인해 제3자에게 불측의 손해가 발생되지 않도록 하기 위해 일정한 요건을 만족하는 경우에만 정정이 인정된다.

※실용신안선등록제도는 라이프사이클이 짧은 기술에 대하여 권리를 조기에 부여해야 한다는 사회적 요구에 부응하기 위하여 실용신안등록출원에 대해 방식 및 기초적 요건만을 심사하여 등록하는 제도인 반면 출원인의 책임(보다 완벽한 출원서의 작성, 출원전 선행기술조사)은 보다 증가되었다.

즉, 출원 후 짧은 기간 내에 등록을 받는다는 점에서는 이점이 있으나, 등록 이후 기술평가 과정에서의 정정은 권리의 법적 안정성을 위해 매우 제한적인 범위에서만 허용되므로 출원서 작성에 신중을 기해야 하는 제도이다.

설정등록전의 보정과 기술평가중의 정정의 비교

구분	보 정	정정청구
근 거 규 정	실용신안법 제12조, 제13조, 제14조 및 동법시행규칙 제9조	실용신안법 제 27조
시 기	○ 출원일로부터 2월이내 – 회수 제한 없이 가능 ○ 실용신안법 제12조의 규정에 의한 기초적요건 심사의 보정명령에 의한 보정서 제출 기간 내	○ 실용신안법 제25조제3항의 규정에 의한 심사관의 등록취소 이유통지에 대한 의견서 제출기간 내
범 위	○ 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 범위 내에서 청구항수의 증감, 청구범위의 확장 · 변경 · 감축이 가능	○ 청구범위의 감축, 잘못된 기재의 정정, 분명하지 아니한 기재의 명확화만 가능 – 이 경우에도 신규사항을 추가하거나 청구범위를 실 질적으로 확장, 변경할 수 없으며 – 청구범위의 감축이나 잘못된 기재의 정정인 경우에는 정정후의 청구범위에 기재된 사항이 출원시 등록유지될 수 있는 것이어야 함
불인정	○ 보정에 의해 기초적요건 위배 사항이 해소되지 못한 경우에는 그 실용신안등록출원을 각하함	○ 정정이 인정되지 못하는 것으로 판단되어 정정불인정 이유를 통지받은 경우, 권리자는 의견서와 보정서를 제출할 수 있음

2. 정정청구의 시기 및 회수

- 정정청구는 심사관의 기술평가의견제출통지에 대한 의견서 제출기간(2개월)내에 할 수 있다.
- 정정청구의 횟수는 의견서 제출기간이내이면 제한은 없다.

– 다만 식별항목 또는 식별번호 단위의 부분정정을 하는 경우에 있어서 정정청구서를 두 번 이상 제출하는 경우, 제2차이후의 정정청구는 이전의 정정청구을 포함한다. 예컨데 제1차 정정에서 청구범위 제1항을 정정한 후 제2차 정정에서 제2항을 정정한 경우 제2차 정정은 제1항 및 제2항을 정정한 것이 된다.

3. 정정청구인

- 정정청구인은 실용신안권자이다.
- 실용신안권자는 전용실시권자 · 질권자 또는 통상실시권자가 있는 경우에는 이들의 동의를 얻은 후에만 정정을 청구할 수 있다.

– 이 경우 이들의 동의가 있음을 증명하는 서면을 제출해야한다.

- 실용신안권이 공유인 경우 공유자 전원이 공동으로 청구해야 한다.

4. 정정의 범위

4.1. 기본원칙

- 정정청구는 청구범위를 감축하거나 잘못된 기재를 정정하거나 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 것만 가능하며, 이 경우에 해당된다하더라도 신규사항 추가나 청구범위의 확장 · 변경을 할 수 없으며 또한 당초에 등록유지받을 수 없는 경우에는 인정되지 아니한다.
- 청구범위에 대한 정정에 있어서는 항의 번호를 변경하거나 항을 추가하는 것은 원칙적으로 인정되지 아니한다.
- 정정사항 중 어느 한 곳이라도 정정불인정사유가 있으면 그 정정청구는 불인정된다.

4.2. 정정을 할 수 있는범위

4.2.1. 실용신안법 제27조제2항

- 등록실용신안의 명세서 또는 도면의 정정은 다음에 해당되는 경우에 한하여 인정된다.

1. 실용신안등록청구범위를 감축하는 경우
2. 잘못된 기재를 정정하는 경우
3. 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우

– 다만, 위의 경우에 해당하더라도 신규사항 추가나 청구범위의 확장 · 변경이 아니며 당초에 등록유지받을 수 있는 경우

에만 정정이 인정된다(특허법 제136조제2항 내지 제4항).

① 실용신안등록청구범위를 감축하는 경우

- 청구범위의 감축이라 함은 청구항의 기술적 범위를 감축하는 것과 청구항의 삭제를 말한다.
- 청구범위 감축의 유형
  a. 청구항의 삭제
  b. 택일적으로 기재된 구성요소의 일부삭제
  c. 상위개념의 기재로부터 하위개념의 기재로의 변경
  d. 구성요소의 직렬적 부가
  e. 다수항을 인용하는 종속항에서 인용되는 항의 일부삭제
  f. 수치범위의 축소

a. 청구항의 삭제

- 청구범위의 항을 삭제하는 정정은 청구범위의 감축에 해당되며 정정이 인정된다.

	정정전의 청구범위	정정후의 청구범위	판 단
예 1	1. A에 B가 결합된 장치 2. 1항에 있어서 C가 부가된 장치	1. 삭제 2. A에 B가 결합되고 C가 부가된 장치	인정
예 2	〃	1. A에 B가 결합되고 C가 부가된 장치 2. 삭제	불인정

※(예1) 독립항에 종속되는 종속항이 있고 그 독립항에 등록취소사유가 있어 독립항을 삭제하고 종속항을 예1과 같이 정정하는 경우, 제1항은 청구범위의 감축이며 제2항은 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 것으로 정정은 인정된다.

(예2) 예2와 같이 정정하는 경우, 제2항의 삭제는 청구범위의 감축으로 정정이 인정되나, 제1항은 청구범위의 감축이긴 하나 청구범위를 변경한 것에 해당되어 정정이 불인정되어 전체 정정이 불인정된다(청구범위의 실질적 변경 참조).

	정정전의 청구범위	정정후의 청구범위	판 단
예 1	1. A+B로 된 장치 2. 1항에 있어서 C가 부가된 장치 3. 1항에 있어서 D가 부가된 장치	1. 삭제 2. A+B+C로 된 장치 3. A+B+D로 된 장치	인정
예 2	〃	1. 삭제 2. 삭제 3. A+B+D로 된 장치	인정
예 3	〃	1. 삭제 2. A+B+C로 된 장치 3. 삭제	인정
예 4	〃	1. A+B+C+D로 된 장치 2. 삭제 3. 삭제	불인정
예 5	〃	1. A+B+C로 된 장치 2. 삭제 3. 삭제	불인정
예 6	〃	1. A+B+D로 된 장치 2. 삭제 3. 삭제	불인정
예 7	〃	1.삭제 2. A+B+C+D로 된 장치 3. 삭제	불인정

b. 택일적으로 기재된 구성요소의 일부삭제

- 다수의 구성요소가 택일적으로 기재된 경우 그 중 일부를 삭제하는 정정은 청구범위의 감축이며 정정이 인정된다.

정정전의 청구범위	정정후의 청구범위
○상부판넬과 하부판넬을 볼트 또는 리벳으로 결합시킨 …	○상부판넬과 하부판넬을 볼트로 결합시킨 …

c. 상위개념의 기재로부터 하위개념의 기재로의 변경

정정전의 청구범위	정정후의 청구범위
필기구	만년필

※ 만년필, 연필 등을 포함하는 상위개념인 필기구를 하위개념인 만년필로 정정하는 것은 청구범위의 감축이며 정정이 인정된다. 다만 하위개념인 만년필이 등록명세서에 기재되어 있지 않은 경우에는 신규사항 추가로 정정이 불인정 될 수 있다.

d. 구성요소의 직렬적 부가

정정전의 청구범위	정정후의 청구범위
A+B로 된 장치	A+B+C로 된 장치

※구성요소 C를 직렬적으로 부가한 것은 청구범위의 감축에 해당되나 이러한 직렬적 부가는 대부분 청구범위의 실질적 변경에 해당되어 정정이 불인정된다.

e. 다수항을 인용하는 종속항에서 인용되는 항의 일부삭제

정정전의 청구범위	정정후의 청구범위
제1항 내지 제3항중 어느 한항에 있어서, …을 특징으로 하는 온도 제어장치	제1항 또는 제2항중 어느 한항에 있어서, …을 특징으로 하는 온도 제어장치

※다수항을 인용하는 종속항에서 인용되는 항을 일부 삭제하는 것은 청구범위의 감축이며 정정이 인정된다.

f. 수치범위의 축소

정정전의 청구범위	정정후의 청구범위
○ … 10°~50°C의 온도에서	○ … 24°~25°C의 온도에서

※수치범위의 축소는 청구범위의 감축이며 정정이 인정된다. 다만, 수치범위의 축소라 하더라도 24°~25°C의 범위에서 매우 큰 효과가 나타나고 이러한 사항이 명세서에 기재되어 있지 않은 경우에는 신규사항 추가로 인하여 정정이 불인정될 수 있으며, 또한 명세서에 기재되어 있다 하더라도 10°~50°C의 온도에서의 감기약을 24°~25°C의 에이즈약으로 변경한 경우에는 청구범위의 변경으로 정정이 불인정될 수 있다.

② 잘못된 기재를 정정하는 경우

- 잘못된 기재의 정정이란 명세서 또는 도면의 기재가 잘못된 기재라는 것이 명세서 기재 전체로 보아 자명하거나, 주지의 사항 또는 경험칙으로 보아 명확한 경우에 그 잘못된 기재를 본래의 올바른 기재로 수정하는 것을 말한다.

③ 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우

• 분명하지 아니한 기재를 명확히 하는 것이란 명세서 또는 도면 자체의 명확하지 아니한 기재를 바로잡는 경우와 기재내용 상호간의 불일치나 모순된 부분을 일치시키는 경우를 말한다.

– 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 정정은 신규사항을 추가하거나 청구범위를 실질적으로 확장 · 변경하게 될 가능성이 있으므로 주의하여야 한다.

	정정전의 청구범위	정정후의 청구범위	판 단
예 1	제1항 : A,B,C로 된 물건 제2항 : 1항에 있어서 A는a1,a2 또는a3중 하나로 된 물건	제1항 : 삭제 제2항 : a1,B,C로된 물건 제3항 : a2,B,C로 된 물건 제4항 : a3,B,C로 된 물건	불인정
예 2	〃	제1항 : 삭제 제2항 : A,B,C로 된 물건에 있어서 A는 a1,a2 또는 a3중 하나로 된 물건	인정

※(예1) 제1항은 항을 삭제한 것으로 청구범위의 감축으로 정정인정, 제2항은 택일적 구성요소 a2 및 a3를 삭제한 것으로 청구범위의 감축으로 정정인정, 제3항 및 제4항은 청구범위의 감축, 잘못된 기재의 정정, 분명하지 아니한 기재의 명확화 중 어느 것에도 해당되지 아니할 뿐 아니라 청구항의 추가에 해당되므로 정정불인정. 따라서 예1의 정정은 불인정된다.

(예2) 제3항 및 제4항을 추가하지 아니하고 제2항을 예2와 같이 정정하는 경우에 제2항은 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 것으로 정정이 인정된다.

다만, 설정등록전 자진보정 또는 기초적 요건심사에서 심사관의 보정명령에 의하여 예1과 같이 보정하는 경우 그 보정은 인정된다.

	정정전의 청구범위	정정후의 청구범위	판 단
예 1	제1항 : A,B로 된 장치 제2항 : 1항에 있어서 C를 부가하는 장치 제3항 : 1항 또는 2항 있어서 D를 부가하는장치	제1항 : 삭제 제2항 : A,B,C로 된 장치 제3항 : A,B,D로 된 장치 제4항 : A,B,C,D로 된 장치	불인정
예 2	〃	제1항 : 삭제 제2항 : A,B,D또는 A,B,C,D로 된 장치	인정

※(예1) 예1에 있어서 제1항은 항을 삭제한 것으로 청구범위의 감축으로 정정인정, 제2항은 분명하지 아니한 기재를 명확하게 한 것으로 정정인정, 제3항은 두 개의 고안에서 A, B, C, D로 된 장치라는 고안을 삭제하여 청구범위를 감축한 것으로 정정인정, 제4항은 법 제27조제2항 각호의 어느 것에도 해당되지 아니할 뿐 아니라 청구항의 추가에 해당되므로 정정불인정, 따라서 예1의 정정은 불인정된다.

(예2) 제4항을 추가하지 아니하고 제3항을 "A, B, D 또는 A, B, C, D 로 된 장치"로 정정하는 것은 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 것으로 정정이 인정된다.

4.2.2. 특허법 제136조제2항 내지 제4항(실용신안법 제27조제4항이 준용하는 특허법 제77조제3항에서 준용)

• 실용신안법 제27조제2항의 규정에 의한 정정은 다음의 요건들을 만족하여야 한다.

① 등록실용신안의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내일 것. 단, 잘못된 기재를 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내일 것(특허법 제136조제2항)

② 실용신안등록청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것이 아닐 것(특허법 제136조제3항)

③ 정정이 청구범위의 감축이나 잘못된 기재의 정정에 해당하는 경우에는 정정후의 실용신안등록청구범위에 기재된 사항이 실용신안등록 출원시 등록유지될 수 있는 것일 것(특허법 제136조제4항)

① 등록실용신안의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내일 것

• 명세서 또는 도면의 정정은 등록실용신안의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서만 할 수 있다. 단, 잘못된 기재를 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서만 할 수 있다.

• 요약서는 명세서 또는 도면의 일부가 아니므로 요약서에 기재되어 있으나 명세서 및 도면에 없는 사항을 정정에 의하여 명세서 또는 도면에 추가하는 것은 신규사항을 추가한 것에 해당되어 정정이 불인정된다.

• 새로운 실시예를 추가하는 것은 원칙적으로 신규사항 추가에 해당되어 정정이 불인정된다.

• 고안을 완성시키는 정정은 고안의 미완성 상태에 무언가 새로운 내용이 추가됨에 따라 고안이 완성된 것이므로 신규사항이 추가된 것으로 정정이 불인정된다.

• 고안이 달성하는 효과, 이론, 실험데이터 등을 추가하는 것이 실용신안등록청구범위를 실질적으로 변경하지 않더라도, 그것이 정정 전의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내가 아니면 신규 사항을 추가한 것에 해당되어 정정이 불인정된다.

② 실용신안등록청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것이 아닐 것

• '청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것'이란 청구범위에 기재된 당해 고안의 구성에 없어서는 아니 되는 사항에 대하여 그 내용 특히 범위, 성질 등을 확장시키거나 변경시키는 것, 즉, 정정 전 · 후에 실용신안권의 효력이 미치는 범위에 차이가 생기는 것을 말한다.

– 청구범위의 실질적 확장 또는 변경에는 ①청구범위의 기재 자체를 정정함에 의해 실용신안권의 효력이 미치는 범위를 확장 또는 변경하는 경우와 ②청구범위를 전혀 정정하지 않더라도 상세한 설명 또는 도면의 기재를 정정함에 의해 간접적으로 실용신안권의 효력이 미치는 범위를 확장 또는 변경하는 경우가 있다.
– 청구범위의 실질적 확장 · 변경여부는 각 청구항별로 판단한다.

※구성요소를 직렬적으로 부가하여 청구범위를 감축하는 정정은 청구범위를 실질적으로 변경하는 것으로 이어지는 경우가 많으므로 유의하여야 한다.

• 청구범위를 확장 또는 변경하는 정정의 유형은 다음과 같다.
– 청구범위를 실질적으로 확장한 경우
  a. 청구항에 기재된 직렬적 구성요소의 삭제
  b. 청구항에 택일적으로 기재된 구성요소의 부가
  c. 청구항에 기재된 구성요소를 상위개념으로 변경
  d. 청구항의 추가 또는 실시예의 추가
  e. 청구항에 기재된 수치범위의 확장
  f. 인용항의 추가
– 청구범위를 실질적으로 변경한 경우
  g. 정정에 의하여 미완성 고안을 완성시키는 경우
  h. 청구항에 기재된 구성요소의 치환
  i. 수치범위의 변경
  j. 정정에 의하여 청구범위가 감축되는 경우에도 정정 전의 청구항에 기재된 사항에 의하여 구성되는 고안의 구체적인 목적의 범위를 일탈하여 그 기술적 사항을 변경하는 경우
  k. 고안의 대상이 변경된 경우
  l. 청구항에 구성요소의 직렬적 부가
– 확장 또는 변경
  m. 청구범위의 정정이 없더라도 명세서의 상세한 설명이나 도면을 정정함으로써 청구범위에 기재된 기술적 사상이 실질적으로 확장 또는 변경되는 경우

a. 청구항에 기재된 직렬적 구성요소의 삭제

정정전의 청구범위	정정후의 청구범위
양자를 일체로 하여 동일 용기내에 수납하고, 또한 양전원장치의 동전위를 결합시켜서 2개의 선으로 인출한 입자가속기의 구조	양자를 일체로 하여 동일 용기내에 수납한 입자가속기의 구조

※양 전원장치의 동전위점을 결합시키고, 2개의 선으로 인출하는 구성을 삭제하여 청구범위의 확장으로 정정이 불인정된다.

b. 청구항에 택일적으로 기재된 구성요소의 부가

정정전의 청구범위	정정후의 청구범위
상부판넬과 하부판넬을 볼트로 결합시킨… .	상부판넬과 하부판넬을 볼트 또는 리벳으로 결합시킨 …

※"볼트"를 "볼트 또는 리벳"으로 하는 것은 택일적 기재요소를 부가한 것으로서 청구범위를 확장하여 정정이 불인정된다.

c. 청구항에 기재된 구성요소를 상위개념으로 변경

정정전의 청구범위	정정후의 청구범위
만년필	필기구

※필기구에 포함되는 하위개념인 만년필을 만년필, 연필, 볼펜 등을 포함하는 상위개념인 필기구로 정정함에 의해 청구범위가 확장되어 정정이 불인정된다.

d. 청구항의 추가 또는 실시예의 추가

청구항을 추가하는 것은 실용신안등록청구범위를 확장하는 것에 해당되어 정정이 불인정되며, 새로운 실시예를 추가하는 것은 일반적으로 청구범위를 해석을 통하여 확장시킬 수 있고 또한 신규사항 추가로 정정은 인정되지 않는다.

e. 청구항에 기재된 수치범위의 확장

정정전의 청구범위	정정후의 청구범위
… 탄소 3~4%를 포함하는 …	… 탄소 3~4%를 포함하는 …

※수치범위의 확장은 청구범위가 확장되어 정정이 불인정된다.

f. 인용항의 추가

인용항의 추가는 청구범위를 확장하여 정정이 불인정된다.

정정전의 청구범위	정정후의 청구범위
청구항1에 있어서	청구항1 또는 청구항2에 있어서

g. 미완성 고안을 정정에 의하여 완성시키는 경우

등록 명세서상의 미완성부분을 정정 명세서에 의하여 그 기술적 이면을 분명히 해서 완성된 고안으로 하는 정정은 무에서 유를 생기게 한 것과 같으며 기술적 사항을 실질적으로 변경한 것에 해당되어 정정은 불인정된다.

h. 청구항에 기재된 구성요소의 치환

정정 전의 청구항에 기재된 구성요소 D를 상세한 설명에 기재되어 있는 X로 치환하여 청구범위가 변경되는 경우 그 정정은 불인정된다.

정정 전의 청구항에 기재된 구성요소 D를 상세한 설명에 기재되어 있는 균등물 X로 치환하는 것은 청구범위의 감축, 잘못된 기재의 정정, 분명하지 아니한 기재의 명확화 중 어느 것에도 해당하지 아니하므로 그 정정은 인정될 수 없으며 또한 청구범위의 실질적 변경에 해당될 경우 정정은 불인정된다.

정정전의 청구범위	정정후의 청구범위
A+B+C+D	A+B+C+X

i. 청구항에 기재된 수치범위의 변경

정정전의 청구범위	정정후의 청구범위
… 10°~11°C의 온도에서 …	… 10°~11°F의 온도에서 …

※수치범위의 변경은 청구범위가 변경되어 정정이 불인정된다.

j.정정에 의하여 청구범위가 감축되는 경우에도 정정 전의 청구항에 기재된 사항에 의하여 구성되는 고안의 구체적인 목적의 범위를 일탈하여 그 기술적 사항을 변경하는 경우

정정전의 청구범위	정정후의 청구범위
(청구범위) … 집점에 대하여 45도의 각도로 1매의 반사경을 정치하고 그 반사경을 셔터를 누를 때에만 암상자내의 저판에 대략 평행하게 되도록 자동적으로 하강하도록 하고 또 셔터를 다 누르고 나면 상기 암상자내의 저판에 대략 평행하게 있는 반사경을 암상자내에 장치한 스프링에 의하여 자동적으로 원위치에 복귀되도록 한 것을 특징으로 하는 일안(一眼)레플렉스카메라 * 정정 전 · 후의 도면과 상세한 설명은 동일함	(청구범위) … 집점에 대하여 45도의 각도로 1매의 반사경의 후단연과 계지하는 2차반사방지용 차광판을 그 기단에서 추착(樞着)시킴과 동시에 그 반사경을 … … 복귀되도록 하고 또한 반사경의 하강 상승에 관련하여 2차반사방지용차광판을 기복이 자재하게 회동할 수 있도록 한 것을 특징으로 하는 일안(一眼)레플렉스카메라

※고안의 구체적 목적을 달리하는 새로운 구성요건을 부가하는 것은 실질적으로 청구범위를 변경시키는 것으로 정정이 불인정된다.

k.고안의 대상이 변경된 경우

정정전의 청구범위	정정후의 청구범위
승용차의 형태로 신속하게 변형 시키는 장치로서 승용차의 형태에 있어서는 후부좌석의 背部와 미부게이트사이에 수평으로 연장되어서 후부차실, 즉 이하 2개의 화물 넣는 곳으로 분할 시키고------ 특징으로 하는 장치	구비한 자동차에 있어서, 상기 최후장의 좌석과 상기 미부게이트 사이에 실질적으로 수평으로 연장되어서 상기 후부차실을 상하 2개의 실로 분할 시키는 격벽부재를 ------ 특징으로 하는 자동차

※정정전의 청구범위에 기재된 고안의 대상물은 승용차의 형태로 신속하게 변환시키는 장치인데 대하여, 정정된 청구범위의 대상물은 자동차로서 이것은 실질적으로 청구범위를 변경한 것에 해당되어 정정이 불인정된다.

l.청구항에 구성요소의 직렬적 부가

정정전의 청구범위	정정후의 청구범위
제1항 : A,B로 된 물품	제1항 : A,B,C로 된 물품

※제1항에 구성요소 C를 부가하여 청구범위를 감축하였으나, 청구범위를 실질적으로 변경한 것에 해당하므로 정정이 불인정되며 이 경우 구성요소 C가 정정전의 명세서에 기재되어 있다 하더라도 청구범위의 실질적 변경을 회피할 수 없다.

m.청구범위의 기재에 정정이 없더라도 명세서의 상세한 설명이나 도면을 정정함으로써 청구범위에 기재된 기술적사상이 실질적으로 확장 또는 변경되는 경우에는 정정이 불인정된다.

③ 정정이 청구범위를 감축한 경우 또는 잘못된 기재를 정정한 경우에는 정정 후의 실용신안등록청구범위에 기재된 사항이 실용신안등록 출원시 실용신안등록유지를 받을 수 있는 것

- 청구범위를 감축하거나 잘못된 기재를 정정한 청구항이 실용신안등록(등록유지결정)을 받을 수 없는 경우 그 정정은 실용신안법 제27조제4항에서 준용하는 특허법 제136조제4항에 위반되므로 정정은 불인정된다.

5. 정정명세서 등의 보정제도

5.1. 일반적 기준

- 정정청구서의 보정은 그 요지를 변경하지 아니하는 한도 내에서가능하다(실용신안법 제27조제4항에서 준용되는 특허법 제140조제2항).
  - 따라서, 정정 명세서 또는 도면에 대한 보정은 그 보정에 의해 정정청구 취지의 요지가 변경되지 않는 한도 내에서만 인정된다.
- 청구취지의 요지가 변경된다는 것은 정정청구의 취지를 구성하는 정정사항의 범위나 동일성을 변경하는 것으로, 당초의 정정사항 이외에 새로운 정정사항을 추가하거나 당초의 정정사항을 보정하더라도 보정에 의해 당초의 정정청구에 비해 추가적인 심리가 필요하게 되는 경우를 의미한다.
  - 정정명세서 등에 대한 보정제도의 취지는 전체 정정사항 중 일부가 불인정될 경우에 불인정된 부분만을 삭제하거나 정정을 하면서 발생된 명백한 오탈자 등을 보정할 수 있는 기회를 제공함으로써 전체 정정청구서가 불인정되는 것을 방지하기 위한 것이다.

5.2. 청구취지 변경의 유형 및 판단기준

- 추가적 변경
  정정사항과 별개인 새로운 정정사항을 추가하는 것으로 청구취지의 요지를 변경하는 것으로 보아 보정은 불인정된다.
  - 정정청구하지 아니한 구성요소의 삭제는 새로이 정정사항을 추가하는 것으로 보정은 인정되지 아니한다.
  - 새로운 구성요소의 추가는 새로이 정정사항을 추가하는 것으로 보정은 인정되지 아니한다.
  - 정정청구하지 아니한 청구항의 삭제는 새로이 정정사항을 추가하는 것으로 보정은 인정되지 아니한다.
- 감축적 변경
  정정사항을 철회하여 등록명세서대로 복귀하는 것으로 청구취지의 요지를 변경하지 않는 것으로 보아 보정은 인정된다.
  - 구성요소 A를 A′로 정정한 후 다시 A로 보정하는 것은 감축적 변경으로 보정은 인정된다.
  - 정정에서 삭제한 청구항을 등록명세서대로 복귀하는 것은 감축적 변경으로 보정은 인정된다.
  - 정정사항이 A(청구범위의 감축) 및 B(오기의 정정)이었던 것을 A 또는 B만으로 하는 보정은 감축적 변경으로 인정된다.
- 교환적 변경
  종래의 정정사항을 새로운 정정사항으로 교환하는 것으로 정정청구 취지의 요지를 변경한 것으로 보아 보정은 불인정된다. 다만 추가적인 심리가 필요하지 아니하는 한도 내에서 청구항의 정정된 구성요소를 상위개념에서 하위개념

으로 변경하거나, 정정된 수치범위를 더욱 축소하거나, 하나의 구성요소를 다수의 구성요소로 정정한 경우에 있어서 그 구성요소 중 일부를 삭제하는 보정은 요지를 변경하지 아니한 것으로 인정된다.

– 정정한 청구항을 삭제하는 보정은 교환적 변경이나 청구취지의 요지가 변경되지 않은 것으로 보정은 인정된다.

구 분	청구범위	보정인정 여부
등록명세서	A+B+(C또는D)	–
정정명세서	A+B+C	–
보정명세서(예1)	A+B+D	불인정
보정명세서(예2)	A+B+C′ (C′ 는 C의 하위개념)	인정*

구 분	청구범위	보정인정 여부
등록명세서	A성분의 함유량 10~90%	–
정정명세서	A성분의 함유량 60~80%	–
보정명세서(예1)	A성분의 함유량 20~40%	불인정
보정명세서(예2)	A성분의 함유량 65~75%	인정*

* 상위개념에서 하위개념으로 변경하거나 수치범위를 더욱 축소하는 경우 보정은 인정된다. 다만 변경이나 축소로 인하여 추가적인 심리가 필요한 경우 보정은 불인정된다.

5.3. 판단사례

1. 등록명세서 및 정정명세서

구 분	청구범위의 기재내용
등록 명세서	**칫솔모(A)**가 식모되고 **항균물질로 코팅된(B)** 브러시부와 일단이 브러시부와 **나사결합되며(C)** 타단에 걸이용 홈이 형성된 손잡이 부로 구성된 분리형 칫솔 … A … B … C …
정정 명세서	**다각형 단면의 칫솔모(A′)**가 식모되고 **항균물질로 코팅된(B)** 브러시부와 일단이 브러시부와 **나사결합되며(C)** 타단에 걸이용 홈이 형성된 손잡이부로 구성된 분리형 칫솔 … A′ … B … C …

2. 보정명세서

사례	보정명세서		
1	**칫솔모(A)**가 식모되고 **항균물질로 코팅된(B)** 브러시부와 일단 이 브러시부와 **나사결합되며(C)** 타단에 걸이용 홈이 형성된 손잡이부로 구성된 분리형 칫솔		
	… A … B … C …	감축적 변경	인정
2	삭제		
	청구항 삭제	교환적 변경	인정
3	**다각형 단면의 칫솔모(A′)**가 식모되고 **항균물질로 코팅된(B)** 브러시부와 일단이 브러시부와 **끼움 결합되며(C′)** 타단에 걸이용 홈이 형성된 손잡이부로 구성된 분리형 칫솔		
	… A′ … B … C′ …	추가적 변경	불인정
4	**다각형 단면의 칫솔모(A)**가 식모된 브러시부와 일단이 브러시부와 **나사결합되며(C)** 타단에 걸이용 홈이 형성된 손잡이부로 구성된 분리형 칫솔		
	… A′ … (B삭제) … C …	추가적 변경	불인정
5	**육각형 단면의(A′′)** 칫솔모가 식모되고 **항균물질로 코팅된(B)** 브러시부와 일단이 브러시부와 **나사결합되며(C)** 타단에 걸이용 홈이 형성된 손잡이부로 구성된 분리형 칫솔		
	… A′′ … B … C …	교환적 변경	인정*
6	**다각형 단면의 칫솔모(A′)**가 식모되고 **은이 코팅된(B′)** 브러시부와 일단이 브러시부와 **나사결합되며(C)** 타단에 걸이용 홈이 형성된 손잡이부로 구성된 분리형 칫솔		
	… A′ … B′ … C …	추가적 변경	불인정
7	**다각형 단면의 칫솔모(A′)**가 식모되고 **항균물질로 코팅된(B)** 브러시부와 일단이 브러시부와 **나사결합되며(C)** 타단에 걸이용 홈과 **요철부(D)**가 형성된 손잡이부로 구성된 분리형 칫솔		
	… A′ … B … C … D(추가) …	추가적 변경	불인정

3. 보정의 인정여부

– 상기의 정정사례는 등록명세서에 기재된 "칫솔모"(A)를 "다각형 단면의 칫솔모"(A′)로 정정한 경우이다.

– 사례1은 등록명세서에 기재된 "칫솔모"(A)로부터 "다각형 단면의 칫솔모"(A′)로의 정정사항을 삭제하여 등록명세서의 기재대로 복귀하는 것으로 감축적 변경으로 인정된다.

– 사례2는 정정청구된 청구항 자체를 삭제하는 것으로 교환적 변경으로 인정된다.

– 사례3은 정정청구되지 아니한 "나사결합되며"(C)를 "끼움결합되며"(C′)로 대체하는 추가적 변경으로 불인정된다.

– 사례4는 정정청구되지 아니한 "항균물질로 코팅된"(B)을 삭제하는 보정으로서 정정명세서의 보정에 의해 새로운 정정사항이 추가되었으므로 추가적 변경으로 불인정된다.

– 사례5는 정정된 "다각형 단면의 칫솔모"(A′)를 그 하위개념인 "육각형 단면의 칫솔모"(A′′)로 변경한 것로서 교환적 변경이긴 하나 추가적인 심리가 필요하지 아니하는 경우 청구취지를 변경하지 아니한 것으로 보아 인정된다.

– 사례6은 정정되지 않았던 "항균물질을 코팅한"(B)을 하위개념인 "은을 코팅한"(B′)로 보정하여 새로운 정정사항을 추가한 추가적 변경으로 불인정된다.

– 사례7은 새로운 구성요소 "요철부"(D)를 추가하여 정정사항을 추가한 것으로 보정은 불인정된다.

5.4. 정정명세서 등의 보정에 대한 인정여부 판단시 유의사항

• 정정명세서 등의 보정에 대한 인정요건을 판단할 때 정정청구의 인정요건을 만족하는지 여부는 판단하지 아니한다.

– 정정명세서 등의 보정에 대한 인정요건은 실용신안법 제27조제4항에 의해 준용되는 특허법 제140조제2항이며, 정정청구의 인정요건은 실용신안법 제27조제2항과 동법 동조제4항에 의해 준용되는 특허법 제136조제2항 내지 제4항으로서 서로 다르기 때문이다.

• 정정명세서 등의 보정에 대한 인정요건은 엄격하게 적용된다.

– 추가적 변경이나 교환적변경(예외적으로 인정되는 경우 제외)을 허용하게 되면 정정명세서 등의 보정제도를 정정청구를 한 번 더 하는 기회로 이용하는 경우가 발생될 수 있어 이는 정정명세서 등의 보정제도의 취지와 부합되지 않는다.

• 정정명세서 등의 보정에 의해 정정청구가 적법한 것으로 되는지 여부는 정정명세서 등의 보정에 대한 인정여부에 영향을 미치지 아니한다.

– 즉, 정정명세서 등의 보정에 대한 인정여부와 정정청구의 인정여부는 독립적으로 판단한다.

– 따라서, 보정이 인정되더라도 보정이 포함된 정정청구가 부적법한 것으로 인정될 경우 그 정정은 불인정된다.

한국특허정보원 신임 원장에 유영기 전 특허심판원 심판장 취임

한국특허정보원(www.kipi.or.kr) 신임 원장에 유영기(兪永基) 전 특허심판원 심판장이 선임됐다.

한국특허정보원 이사회(이사장 이상복)는 지난 10월 7일 임시이사회를 열고 민경탁 전 원장(現 한국발명진흥회 부회장)의 후임으로 유영기 전 특허심판원 심판장의 선임을 의결했다.

이번 신임원장 선임은 중앙인사위원회 「정부산하기관 인사운영쇄신 지침」에 따라 공모에 의하여 응모한 후보자를 원장추천위원회에서 최종 선정하여 이사회에 추천, 의결하는 방식으로 시행됐다.

유영기 신임 원장은 연세대학교 기계공학과, 미국 워싱턴대학교 대학원을 졸업하였으며, '74년 제10회 기술고시에 합격하여 공직을 시작하였으며, 주요 근무부처로는 공업진흥청, 상공부 산업진흥과장, 항공방위산업과장, 특허청 자동차심사담당관, 국제특허연수원 교수부장, 특허청 심사2국장 등을 거쳐 지난 99년부터 특허심판원 심판장으로 재직해왔다.

이번 이사회의 의결에 따라 지난 10월 20일 오후 2시 한국특허정보원 8층 대회의실에서는 신임 유영기 원장의 취임식이 거행됐다.

유영기 신임 원장은 취임사를 통해 "특허정보원 본연의 업무인 특허정보 보급 활성화, 특허정보 조사분석의 내실화, 특허행정의 원활한 지원 등에 더욱 매진해야 할 것"이라며, 이를 위해 세 가지 운영방침을 제시했다.

유 신임 원장이 제시한 세 가지 운영방침은 다음과 같다.

첫째, 참여정부의 국정원리인 '원칙과 신뢰', '공정과 투명', '대화와 타협', '분권과 자율'의 문화를 한국특허정보원 운영에 적용하여 한층 성숙되고 발전된 조직으로 이끌어 나간다는 방침이다.

둘째, 윤리경영의 실시로서, 보다 신뢰받는 정부산하기관으로 거듭나기 위해 고객감동 서비스를 통한 지식정보화 사회 구축을 기본 모토로, 투명하고 깨끗한 기관 이미지 제고에 노력하겠다고 밝혔다.

셋째, 품질경영기법의 활용을 통해 효율적인 우수한 선진 경영기법을 도입함으로써 품질 우선의 사업수행을 도모하여 양질의 서비스 제공과 함께 특허청의 정확한 특허심사 및 기간 단축을 이룬다는 것이다.

이에 따라 한국특허정보원은 유영기 신임 원장 취임을 계기로 2본부 체제(관리본부, 사업본부)로 조직을 개편, 효율적인 조직운영 및 경영혁신을 도모할 계획이다.

한국특허정보원 관리본부장에 이종익 전 특허청 출원과장 선임, – 사업본부장에는 이재정 현 본부장이 선임.

신임 이종익 관리본부장

한국특허정보원(원장 : 유영기, www.kipi.or.kr)은 2본부 체제 조직 개편에 따라 신설된 관리본부장에 이종익 전 특허청 출원과장이 선임되어 10월 31일 취임했다고 밝혔다.

이종익 신임 본부장은 한국방송통신대학교 경영학과, 한남대학교 대학원을 졸업하였으며, '69년 체신부(현 정보통신부)에서 공직을 시작하여 특허청 총무과 경리계장, 국제특허연수부 학사과장, 특허심판원 심판관을 거쳐 특허청 발명정책국 출원과장으로 재직해 왔다.

한편, 사업본부장에는 한국특허정보원 이재정 현 본부장이 맡게 됐다.

한국특허정보원, 일본특허페어 2003 참가

한국특허정보원은 지난 10월 12일부터 14일까지 일본 동경에서 개최된 일본특허정보페어 2003에 참가했다.

(사)일본발명협회와 (재)일본특허정보기구, 일본공업신문사, 산케이신문사가 공동 주최한 이번 2003 일본 특허정보 FAIR에 우리 정보원은 한국을 대표하는 특허정보서비스 전문기관으로서 지난 99년, 2001년에 이어 세 번째로 참가하였다.

이번 일본특허페어에 참가한 우리 정보원은 일본특허정보의 시장동향, 전시업체의 최신 시스템 현황 등에 대한 파악과 우리 정보원의 해외 인지도 향상, KIPRIS 및 선행기술조사분석 서비스, KPA 등 서비스 마케팅 극대화를 위해, 총 8명의 참가단을 구성, 일본 현지의 특허 관련업계와 유관기관 등을 상대로 적극적인 홍보·마케팅 활동을 벌였다.

이번 일본특허페어에는 총 53개 업체가 참여했으며, 전시장의 주요 전시품목은 인터넷, 인트라넷 환경의 선행기술조사, 다국어 번역서비스 및 발명의 출원, 심사청구, 중간처리, 등록 및 권리유지까지의 전 과정을 지원하는 특허종합관리시스템 등이 주류를 이뤘다. 이용자가 요구하는 특정 지적재산과 관련하여 인터넷을 통한 특허교육, 금융공학에 의한 가치평가, 관리, 마케팅 등을 위한 전략컨설팅 및 IP 가치평가 시스템 및 특허맵 작성 등 특허정보 활용을 위한 소프트웨어 전시가 다수를 차지해 눈길을 끌었다.

이번에 처음으로 선보인 우리 정보원 선행기술조사도구 자격루도 일본심사관, 조사업체 담당자 등이 이용방법, 외부서비스 가능여부 및 데이터 현황 등에 대해 많은 관심을 나타내 향후 이에 대한 상품화의 가능성을 높게 했다.

지난 99년 이후 세 번째 참가로 우리 정보원의 해외 인지도 상승과 한국특허정보에 대한 관심이 크게 높아져 정보원 부스의 관람인원 및 상담인원이 크게 증가한 것도 매우 고무적인 일이라 할 수 있다. 3일간 진행된 행사기간동안 정보원 부스를 관람, 상담한 인원은 총 5천여 명, 일일 약 1,600여 명이 다녀갔다.

이와 함께, 진행된 컨퍼런스에서는 「한국의 특허동향」이라는 주제로 한국의 특허동향, 한국특허정보의 활용방법 등에 대한 주제발표를 했다.

또한 이 기간동안 우리 정보원 참가단은 일본공업소유권센터(IPCC) 및 일본특허정보기구(JAPIO), 정보원의 일본 현지 위탁 대리점 인터사이언스사 등을 방문, 각 기관들과의 상호 교류 및 업무협력 증진을 위한 간담회를 갖고 한일 특허정보 교류에 대한 의견을 나누었다.

해외 특허청 관계자 한국특허정보원 방문

⬆ 동남아 특허청 및 중소기업청 관계자 일행

한국특허정보원의 해외 위상이 급속도로 높아지고 있다.

올해에만 10여 차례 해외 특허청 및 특허정보 유관기관의 한국특허정보원 방문이 잇다르고 있는 가운데 지난 9월 중국 지식산권국 관계자의 방문에 이어 10월에도 부탄, 네팔, 스리랑카, 파키스탄 등 동남아 특허청 및 중소기업청 관계자 및 중국 지식산권국 심사관 일행이 방문, 한국특허정보원의 업무현황 및 서비스에 대한 지식을 습득했다.

⬆ 중국 지식산권국 심사관 일행

이들 해외 특허청 관계자들은 한국특허정보원의 보유 데이터 및 제공 서비스에 대해 놀라움을 감추지 못했으며 특히, 한국특허정보의 인터넷 무료 서비스(KIPRIS) 제공에 대해 깊은 관심을 나타냈다.

부탄 무역산업부 산업과 Phub Dorji 과장은 "정보통신 강국답게 특허정보를 인터넷을 통해 무료로 국민들에게 제공하는 방식이 매우 부럽다"고 말했다.

또 중국 지식산권국 심사관 일행도 "KIPRIS를 통해 상표의 명칭, 도면 등을 한눈에 찾아볼 수 있어 참으로 편리한 서비스"라고 극찬했다.

한국특허정보원은 지속적으로 급증하는 해외 특허청 및 유관기관의 방문을 계기로 국제경쟁력 강화 방안을 구축할 계획이다.

지난 10월 24일 개최된 2003 특허가족 추계 체육대회에 참가한 한국특허정보원

KIPRIS 검색가능 최종 데이터 현황

(2003.11.7 현재)

구 분	종 류	기 준 일	정보제공범위	구 분	종 류	기 준 일	정보제공범위
특 허 / 실 용	공개서지	공 개 일	2003.10.22	의 장	등 록	공 고 일	2003.11. 3
	공고서지	공 고 일	2003.10.22		공개(조기)	공 개 일	2003.11. 5
	초 록	공 보 일	2003.10.22	심 판	1심 ~ 3심	청 구 일	2003.10.29
	전문이미지	공 보 일	2003.10.22	4권리	등 록	등 록 일	2003.11. 3
상 표	서지/이미지	방식심사일	2003.11. 6	4권리	중간처리	서류접수일	2003.11. 5
특 허	생명공학	출 원 일	1980 ~ 2002	특 허	KPA	등록·공고	1979.1 ~ 2000.10
						특허공개	2000.1 ~ 2003.5

난치성 질환, 인간화 항체로 정복한다.

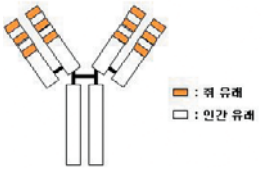
선진 각국의 제약업체와 생명공학 관련 연구소들을 중심으로 이른바 "인간화 항체(humanized antibody)" 제조기술에 대한 연구와 이를 이용한 난치병(암, 에이즈, 치매 등)치료제 개발이 활발하게 이루어지고 있는 가운데, 이 분야의 국내특허 출원도 2001년 이후 급증하고 있다.

원래 항체는 체내에 침입한 외부물질에 대한 방어작용의 일환으로 체내에서 만들어지는 것이나, 최근 이들 항체를 체외에서 제조한 후 인체에 투입하여 항원(예 : 암세포, 에이즈 바이러스)과 싸우게 함으로써 난치성 질환의 치료에 활용하려는 시도가 활발하게 이루어지고 있다.

항체를 외부에서 체내로 투입하는 경우 가장 큰 문제점은 인체가 이를 새로운 항원으로 인식하고 거부반응을 일으키는 것인데, 이러한 문제점을 해결하는 것이 인간화 항체 제조기술의 핵심부문이다.

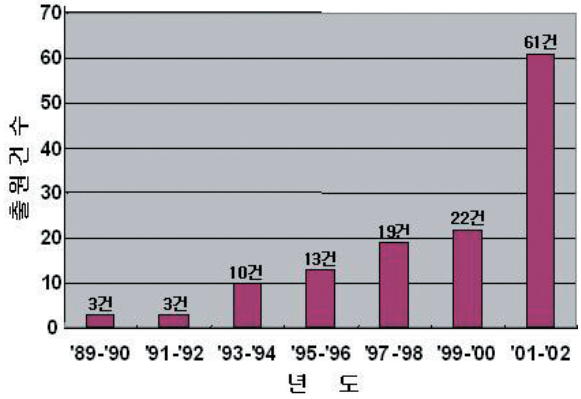
다시 말해서 인간화 항체란 유전자 재조합 기술을 이용하여 체내의 항원을 인지하는데 필요한 최소한의 부분을 제외하고는 쥐유래의 서열을 인간의 항체서열로 대치한 항체이다(도 1).

도 1. 인간화 항체



즉 항체의 치료용 부분은 쥐유래의 서열로 구성하고 그 외의 부분은 인체친화적인 성분으로 구성함으로써 항체의 치료효과는 유지하면서 거부반응을 일으키지 않도록 한 것이다.

도 2. 년도별 인간화 항체 관련 특허출원수

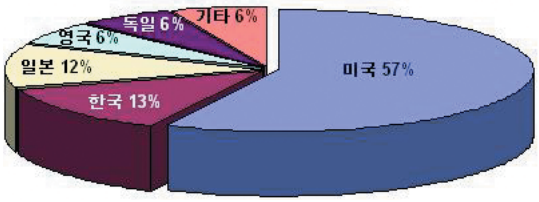


인간화 항체는 화학물질에 비해 치료효과가 높고 부작용은 적은 반면 개발기간이 짧고 부가가치가 높기 때문에 미국 등 선진국에서 R&D 투자가 활발하게 진행되고 있으며, 현재 Herceptin(유방암 치료제), Zenapax(면역억제제) 등의 인간화 항체가 시판 중에 있다.

인간화 항체관련 국내 특허출원 현황을 살펴보면 1989년 최초출원부터 2002년까지 총 131건이 출원되었는데, 2001년과 2002년 두해동안 절반 가까운 61건이 출원되었다(도 2).

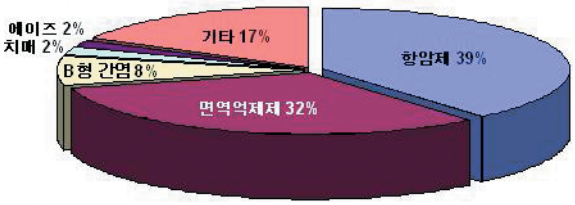
출원인 국적을 살펴보면, 미국이 57%(75건)로 압도적으로 많으며, 한국 13%(17건), 일본 12%(15건), 영국, 독일이 각각 6%(8건), 기타나라가 6%(8건)이다(도 3).

도 3. 출원인 국적별 인간화 항체 관련 특허출원수



기술내용별로는 항암제가 39%로 가장 큰 비중을 차지하고 있고, 면역억제제(32%), B형간염치료제(8%), 치매치료제(2%), 에이즈치료제(2%) 등이 그 뒤를 잇고 있다(도 4).

도 4. 기술 내용별 인간화 항체 관련 특허출원 비율



기타 : 혈전증, 당뇨병, 감염증 등

내국인 출원의 경우 총 17건 중 9건이 B형간염치료제로서 이 분야에서는 우리나라가 선도적인 역할을 하고 있음을 알 수 있다.

앞으로 국내 제약업체, 바이오 벤처기업들이 인간화 항체 분야에 집중적으로 투자한다면 고부가가치를 창출할 수 있을 뿐만 아니라 우리나라가 BT산업분야에서 선진국으로 도약할 수 있는 계기가 될 것으로 기대된다.

국제특허분류(IPC), 이렇게 달라진다.
– 국제적인 특허분류를 정보화 시대에 맞도록 대폭 개편

특허기술에 대한 표준분류인 국제특허분류(IPC, International Patent Classification)의 기본 틀을 바꾸기 위한 국제적인 논의가 세계지적재산권기구(WIPO, World Intellectual Property Organization)를 중심으로 활발하게 진행되고 있는 것으로 알려졌다.

국제특허분류(IPC)는 1975년 발효된 「특허분류에 관한 스트라스부르그(Strasbourg) 협정」에서 채택된 국제적으로 통일된 특허문헌의 분류기준이다. 그러나 20여 년 전의 시대적 환경에 따라 서면에 의한 특허문헌의 분류 및 검색을 중심개념으로 하여 분류체계가 만들어졌기 때문에, 컴퓨터와 인터넷을 기반으로 한 정보화가 급속하게 진행된 오늘날에는 사용하기 불편하고 빠른 속도로 발전하는 신기술을 신속하게 수용하지 못한다는 비판이 그 동안 계속해서 제기되어 왔다.

이에 따라, 지난 '99년 세계지적재산권기구는 2004년 상반기까지 IPC의 전면적인 개혁을 완료한다는 목표 아래 IPC전문가위원회(IPC Committee of Experts) 산하에 「IPC개혁작업반(IPC Reform Working Group)」을 설치하고 중점 추진과제를 선정하여 개혁 작업을 진행하여 왔다.

따라서, 새로운 IPC는 2004년 7월 1일까지 발간 · 배포되어 6개월간의 준비기간을 거쳐 2005년 1월 1일부터 공식 사용될 것으로 보인다.

이번에 대폭 개정되는 국제특허분류의 주요 특징은 단일의 분류체계(6만여개의 분류기호)로 운용되던 현재의 방식을 변경하여, 향후에는 분류기호의 갯수가 현재의 1/3정도로 축소된 기본IPC(대분류 2만여개의 분류기호를 가진 분류체계)와 현재보다 더욱 확대된 확장IPC(세분류 7만 여개 이상의 분류기호를 가진 분류체계)로 이원화하여 각국의 실정에 따라 선택적으로 사용할 수 있도록 할 예정이다.

또 현재는 5년마다 IPC를 개정하였으나, 앞으로는 최신기술을 즉시 IPC에 반영할 수 있도록 하기 위해 기본IPC는 3년마다, 확장IPC는 필요에 따라 수시로 개정할 수 있도록 하였다.

또한, 일반인들이 특허분류를 좀 더 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위해 분류기호에 해당되는 그림, 도표, 상세 설명자료 등을 IPC에 추가하기로 하였으며, 회원국이 이미 분류를 부여한 기존의 특허문헌에 대해서도 새롭게 바뀐 분류를 신속히 변경하여 부여하고, WIPO가 관련 자료를 회원국으로부터 모두 수집하여 하나의 분류데이터베이스를 구축하기로 하였다.

한편, WIPO는 자체 홈페이지에 IPC 웹사이트(Web Site)를 개설하고, 회원국이 IPC 개정 제안서를 제출하면 개정작업반이 즉시 이를 검토하여 인터넷을 이용한 의견교환을 통해 신속한 IPC 개정이 가능하도록 하였다.

이번 특허분류 개정에 따른 기대효과로는, IPC에 신기술을 신속히 도입할 수 있을 뿐만 아니라 IPC 사용자 등의 이용편의가 도모되어 과학 · 기술 분야에서 선행기술의 분류 및 검색에 IPC를 보다 광범위하게 활용할 수 있는 계기가 마련될 것으로 기대된다.

우리나라는 지난 ⑨년 IPC협정에 가입하여 정식 회원국이 된 이후 IPC 개혁을 위한 국제적 논의에 적극적으로 참여하여 왔으며, 이를 바탕으로 새로운 IPC가 국내 연구계 및 학계의 기술개발에 보다 많이 활용될 수 있도록 하기 위해 특허청 홈페이지 등을 통해 이를 적극 홍보할 계획이다.

국제특허분류(IPC)
(International Patent Classification)

1. 의의
- 국제적으로 통일된 특허기술의 분류 체계

2. IPC의 필요성
- 전세계적으로 매년 발간되는 특허문헌의 양이 방대하므로 이를 용이하게 검색하기 위해서는 기술별로 정리할 수 있는 분류체계 필요

3. IPC의 제정
- 국제특허분류에 관한 스트라스부르그(Strasbourg) 협정에 의함(1975년 10월 발효)

※가입현황 : 2003. 8월 현재 54개국 가입
(우리나라는 '99. 10. 8 정식회원국)

4. IPC의 개정
- 5년마다 개정
- 현재는 제7판 사용 중
(2000년1월1일 – 2004년12월31일까지 사용)
- 2005년 이후: 정보화 시대에 맞춰 대폭 개편된 IPC를 사용

5. IPC 이용현황

- 2003. 8월 현재, 회원국(54개국)을 포함하여 전세계 약100여개국이 사용
- 2003. 8월 현재, 약 2천8백만 특허문헌(전세계 특허 문헌의 약95%에 해당)이 IPC 기호를 부여

6. IPC의 구조

- IPC는 섹션(Section), 클래스(Class), 서브클래스(Sub-Class), 메인그룹(Main-Group) 및 서브그룹(Sub- Group)의 계층 구조로 되어있음

국제 특허분류의 사례(축구화)

분 류 기 호	A	43	B	5/00	5/02	구 분
분 류 타이틀	생활필수품	신발류	신발류의 특징	스포츠용	축구화	

섹션
클래스
서브 클래스
메인 그룹 (대분류)
서브그룹 (세분류)

7. IPC 개혁작업 추진배경 및 경과

- 추진배경
  - 특허문헌을 서면으로 발간하고 이를 검색하는 개념을 기초로 하여 만들어진 국제특허분류(IPC)는 전자문서에 의한 특허문헌 발행 및 전산검색이 일반화된 오늘날에는 그 효용성이 저하되고 있어, 정보화 시대에 효과적으로 이용할 수 있도록 IPC 체계를 근본적으로 수정할 필요성이 대두됨
- 경과
  - '99년 IPC에 관한 정책을 담당하는 공식의결기구인 IPC전문가위원회(모든 회원국의 IPC전문가로 구성)는 국제특허분류(IPC)를 2004년까지 개혁하기로 결정하였으며,
  - 전문가위원회 회의를 통해 IPC를 기본IPC(Core-level)와 확장IPC (Advanced-level)의 이중구조로 개편하기로 합의함

8. 기본IPC와 확장IPC의 비교

- 기본IPC는 약 2만여개의 분류갯수를 가진 분류체계로, 가장 기본적인 기술분야만을 포함시킴으로써 넓은범위의 기술분야(대분류)만이 규정되어 있는데 비해, 확장IPC는 기본IPC를 보다 세분화하여 좁은 범위의 기술분야(세분류)까지도 자세하게 규정되어 있음

국제 특허분류의 사례(축구화)

분 류 기 호	A	43	B	5/00	5/02	구 분
분 류 타이틀	생활필수품	신발류	신발류의 특징	스포츠용	축구화	

섹션
클래스
서브 클래스
메인 그룹 (대분류)
서브그룹 (세분류)

  - 예를 들면, 위 사례의 경우 기본IPC에는 스포츠용 신발(A43B 5/00)이라고 대분류까지만 규정되어 있는 반면, 확장IPC에는 이를 더욱 세분화하여 축구화, 농구화, 야구화, 골프화 등으로 세분류까지도 규정되어 있음.

기본 IPC와 확장 IPC의 비교

	기본(Core-level) IPC	확장(Advanced-level) IPC
개정주기	3년마다 개정	수시 개정
기술범위	대분류만을 규정	세분류까지 규정
장점	개정주기가 길어 안정적 사용가능	- 신기술의 신속한 수용가능세분류까지 규정되어있어 기술검색시 유리
단점	신기술의 신속한 수용에 한계	- 개정주기가 짧아 장기적안정성 적음 (수시로 분류 수정이 필요)

유명 스타들의 성명을 사용한 상표출원 급증

세계적으로 널리 알려진 영화배우, 가수, 슈퍼모델 등 연예인들과 스포츠스타들의 인지도를 이용한 성명상표출원이 2000년대 들어 급증하고 있는 것으로 나타났다.

특허청(청장 河東萬)이 '우리나라에서 대중적으로 인지도가 높은 세계적인 유명스타 약 200여명을 대상으로 그들의 성명을 사용한 상표출원 등록현황'을 분석한 자료에 의하면, '90년대 이전까지만 해도 93건에 불과했었고 '90년대에도 308건에 그쳤던 것이, 2000년대 들어 2003년 6월 현재까지 벌써 169건이 출원되어 '90년대와 비교할 때 연평균 60%이상 증가된 것으로 파악되었다.

상표명	출원 건수				등록건수	지정상품
	90년 이전	90년대	2000 이후	소계		
JAMES DEAN	6	70	24	100	54	의류, 가방, 신발, 화장품, 음반, 직물, 시계, 담배, 가구, 문방구,안경, 보석, 주방용품, 모피, 주류등
MADONNA	30	23	5	58	33	화장품, 의류, 가구, 가방, 식품, 신발, 안경, 음반, 주방, 음식업/숙박업
BEATLES	8	24	5	37	19	가방, 신발, 의류, 장신구, 시계, 음반, 운동용품, 음식업/숙박업
ABBA	15	19	2	36	15	가방, 신발, 의류, 안경, 식품, 음반, 전자제품
OMAR SHARE		22	13	35	20	담배, 가방, 신발, 의류, 화장품, 가구, 안경, 귀금속, 장신구, 시계
TIGER WOODS		34		34	9	신발, 의류, 가방, 화장품, 운동용구, 안경, 장신구, 시계
GUUS HIDDINK			30	30		신발, 위류, 운동용품, 음료, 식품, 주류, 화장품, 안경, 음식업
ALAIN DELON	7	16	6	29	17	화장품, 의류, 가방, 안경, 담배, 신발, 주류
MICHEAL JORDAN	3	14	12	29	20	신발, 의류, 가방, 화장품, 안경, 장신구, 주류, 음식업/숙박업
ZICO	4	9	8	21	10	의류, 반도체, 직물, 식품, 보석
MICHEAL JACKSON	3	12		15	8	신발, 의류, 가방, 안경, 오락용품, 운동용품
FIGO			10	10	2	신발, 의류, 가방, 담배, 화장품, 운동용구
JACK NICOLAUSE	2	8		10	6	신발, 의류, 가방, 화장품
PELE	1	3	5	9	2	의류, 가방, 운동용품, 식품, 음료, 보석, 음식업
JOHN WAYNE	5	1	1	7	6	음반, 모피, 의류, 가방, 신발, 화장품, 장신구

세계적인 유명 스타들의 성명을 사용한 동일 유사 상표 출원 등록 현황

가장 많이 출원 등록된 스타는 영화 '이유없는 반항', '에덴의 동쪽'에 출연하여 당시 젊은이들의 우상이던 『제임스 딘(JAMES DEAN)』으로 총 100건이 출원되어 54건이 등록되었고, 두 번째로는 1980년대 섹스심볼로 유명한 『마돈나(MADONNA)』가, 세 번째로는 1960~70년대를 풍미하던 영국의 록그룹 『비틀즈(BEATLES)』가 차지했다.

이외에도 스웨덴의 보컬그룹 『아바((ABBA)』, 영화 '닥터 지바고'의 주인공 『오마 샤리프(OMAR SHARIF)』, 미국의 골프선수 『타이거 우즈(TIGER WOODS)』, 한·일월드컵의 한국팀 국가대표감독 『거스 히딩크(GUUS HIDDINK)』, 미국 NBA농구선수 『마이클 조단(MICHAEL JORDAN)』등이 상위를 차지하고 있다.

유명스타 성명을 상표로 출원한 상품을 보면, 스타들의 특

성과 이미지를 잘 살릴 수 있고 시대적으로 유행성이 강한 '의류'를 중심으로 신발, 가방, 운동용구, 화장품, 장신구, 안경, 시계, 보석 등이 많고 음식점업, 숙박업 등 서비스업에도 출원되고 있다.

이러한 출원 경향은 인터넷, 케이블TV, 위성방송 등 다양한 정보매체를 통해 세계적인 스포츠 경기 및 영화, 공연 등이 실시간으로 안방까지 전달됨으로서 유명 스타들의 동향에 대한 정보를 손쉽게 접할수 있는 시대적인 상황과 맞물려 앞으로 더욱 가속화 될 것으로 예상되고 있다.

현행법에 의하면, 현존하는 유명스타의 성명상표는 스타 본인이 본인 명의로 출원하거나 본인의 승낙을 받은 자가 출원한 경우(상표법 제7조 제1항 제6호) 또는 스타의 성명이 여러 가지 의미를 갖고 있어 본인의 성명으로만 인식되지 않는 경우(예, '마돈나'는 '성모 마리아'의 의미도 있음)에만 상표등록이 가능하고, 저명한 고인의 성명상표의 경우에는, 저명한 고인과의 관계를 허위로 표시하거나 이들을 비방 또는 모욕하거나 이들에 대하여 나쁜 평판을 받게 할 염려가 있는 경우(상표법 제7조 제1항 제2호)등을 제외하고는 등록이 가능하다.

그러나 '제임스 딘'상표분쟁사건의 경우에서 볼 수 있는 것처럼, 적법하게 등록되었음에도 불구하고 분쟁이 발생할 소지는 많은 것이 현실이다.

특허청 관계자는 지난 10여년간 약 30여회의 상표권 등록 무효심판청구사건이 있었음을 지적하면서 "유명스타의 명성에 편승한 상표출원보다는 자기 상품의 이미지에 맞는 독창적인 상표를 개발하여 등록, 사용하는 것이 바람직하다"고 밝혔다.

'IT 지적재산권 풀' 제도 국내 처음 도입

국책 연구기관과 IT중소장비제조업체 관련 기업이 IT지적재산을 서로 공유해 활용하는 IT지적재산권 풀(Pool) 제도가 국내에서 처음으로 선보여 IT지적재산권 사업을 활성화하는데 크게 기여할 것으로 기대된다.

정보통신부는 수출 부진과 수익성 악화로 경영난을 겪고 있는 IT 중소장비제조업체의 경쟁력을 높이기 위해 정보통신지적재산협회(ITIPA)가 구축하려고 하는 "IT지적재산권 라이센스사업"을 IT지적재산권 사업화 기본 인프라 구축 차원에서 적극 지원키로 했다.

정통부가 이 제도 구축을 적극 지원키로 한 것은 최근 미국 등 선진국 IT 관련 유명 기업들이 우수 기술의 라이센싱과 기술료 문제를 해결하기 위해 특허 풀을 운영하는 추세가 늘고 있는 데다, 국내 기업들이 특허 풀에 가입하지 못할 경우 기술료 지급 부담이 커질 수밖에 없는 현실을 감안한 것이다.

특허 풀은 한 기업이 제품을 만들기 위해 여러 특허를 필요로 하는 경우 각각의 특허권자와 특허사용 승낙을 얻기 위해 개별적으로 기술료 협상을 해야하는 시간과 비용부담을 덜어주는 장점이 있다.

우리나라도 지난 90년대 중반 이후 연구개발 사업에 투자를 많이 해 왔으나 개발 성과를 사업화하는 데는 미흡했고, 지적재산권 풀을 통한 라이센싱 실적은 아예 없는 실정이다.
특히 IT중소장비제조업체는 기술개발을 하더라도 자금이 모자라 기술 가치평가 등 자산화를 위한 전문가를 둘 수가 없어 지적재산권을 제대로 관리할 수 없었고 관련 분쟁에도 적절히 대응할 수 없는 어려움을 겪고 있다.

이번에 도입할 IT지적재산권 풀 제도는 정보통신지적재산협회가 라이센스 프로그램 개발 · 운영과마케팅을 전담하여 수익 창출과 기술료를 절감토록 하는 것으로 정보통신지적재산협회는 이를 통해 내년부터 오는 2010년까지 직접수익 1,956만 달러, 기술료 절감 1억 8,932만 달러를 이룬다는 방침이다.

풀 제도가 시행되면 풀에 가입한 IT중소장비제조업체는 풀에 있는 국책 연구기관 등의 우수 기술을 이용할 수 있게 되고, 기술료 관련 국내 · 외 분쟁에 효과적으로 대응할 수 있어 기술료 부담을 크게 덜 수 있게 된다.

또 국책 연구기관도 풀을 통해 기술 거래를 활발히 할 수 있고, 기술거래에 대한 새로운 수익창출로 기술개발자에게 인센티브를 지급하는 등 기술개발을 촉진할 수 있게 된다.

앞으로 개별 기술에 대한 기술가치 평가와 기술보유자 상호 이익배분 문제 등이 해결되어 이 제도가 정착되면 IT 분야뿐 아니라 BT(생명공학), NT(나노기술) 등 다른 분야까지 확산돼 개발된 기술의 자산화와 지적재산권 사업화 기반을 구축함으로써 국가경쟁력과 중소기업체의 경쟁력을 높이는데 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

<출처 : 정보통신부 정보통신정책국>

우리나라 특허권 말레이시아에서도 인정받는다.
– 한국의 특허권이 외국에서 바로 인정받는 획기적 성과 –

앞으로 우리나라에 특허권을 가진 사람은 말레이시아에 한국 특허등록증 사본만 제출하면 말레이시아 특허권을 획득할 수 있게 된다.

지난 10월 27일 말레이시아 특허국은 이 같은 결정을 한국 특허청에 공식 통보해 왔다.

이는 우리 특허권이 외국에서 바로 인정받게 되는 최초의 사례에 해당하며, 지금까지는 우리나라에 특허등록을 받았더라도 말레이시아에서 특허권을 획득하기 위해서는 다시 심사를 받아야만 했다.

이번 조치로 말레이시아에서 신속하고 저렴하게 특허권의 확보가 가능해져, 우리나라의 말레이시아 특허권 획득건수의 증가와 함께, 기업들의 말레이시아 투자 진출이 보다 증가할 전망이다.

현재 말레이시아에서 통상적 절차를 통해 특허권을 획득하기 위해서는 짧게는 4년, 길게는 7년까지 걸리는 점을 감안하면, 이번 조치로 우리 출원인의 말레이시아 특허권 획득기간이 2년 이내로 대폭 단축되게 되었다.

출원수수료 또한 통상적으로 출원할 경우 700RM(약 21만 7천원)를 납부해야 하지만, 이번 조치로 약 36% 인하된 450RM(약 14만원)만 지불하면 되기 때문에 보다 저렴하게 특허권을 획득할 수 있게 되었다.

(※RM : 말레이시아 화폐단위로 1RM(링기트)은 약 310원에 해당)

우리나라 특허권이 최초로 외국에서 무심사 인정되게 됨으로써 한국 특허청과 특허권의 위상이 한층 제고될 것으로 보인다. 현재, 말레이시아에서 특허권의 무심사인정을 받고 있는 국가가 미국, 일본 등 일부 선진국뿐인 점을 감안할 때, 이번 한국 특허권에 대한 무심사 인정은 한국의 특허 심사능력 및 품질이 국제적으로 인정받는 수준까지 향상되었음을 의미하기 때문이다.

이번 성과는 우리나라의 적극적인 지재권 대외협력의 결실이며, 향후 우리나라 특허권의 인정국가 확대의 발판으로 작용할 것으로 기대된다.

말레이시아가 ASEAN의 선도국가인 점을 감안할 때 이번 성과는 싱가포르 등 기타 동남아국가에서도 말레이시아에서와 마찬가지로 무심사로 특허권 획득을 추진하고 있는 노력에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.

※현재 우리나라는 말레이시아에서 11번째 다출원 국가임

– 최근 10년간 우리 국민의 말레이시아로의 특허 출원건수

연도	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02
출원건수	43	50	82	43	43	43	43	43	43	43

Patent 21 2003년 10월호

(통권 제52호)

등록번호 : 서울 라09257
발　　행 : 한국특허정보원
발행 및 편집인 : 유 영 기
주　　소 : 서울시 강남구 역삼동 647-9 한국지식재산센터
편집위원 : 이종익, 이재정, 강치운, 노성열
기　　획 : 최 승 중
광고문의 : 기획팀 (02-3452-8144)
디 자 인 : IDO (02-3445-9849)
인　　쇄 : 세종예술기획

특허기술정보서비스 : www.kipris.or.kr
선행기술조사서비스 : www.forx.org

한국특허정보원
Korea Institute of Patent Information
전화 : (02)3452-8144 FAX : (02)3453-5951

- 정부 위탁 사업 -

- 특허청 선행 기술조사
- 국제특허분류(IPC) 부여
- 특허문서전자화
- 영문초록사업
- 상표조사분석사업
- 특허청 특허고객콜센터 운영
- 특허청 데이터관리센터 운영

- 민간 공익 사업 -

- 무료 특허기술정보서비스(KIPRIS)
- 일반 선행기술조사 서비스
- 벤처기업 인증을 위한 선행기술조사 서비스
- 특허성/기술정보조사
- 이의신청/심판/소송자료조사
- 침해/분쟁 방지조사
- 특허맵(PM)작성 서비스
- 기술가치평가 서비스
- IP컨설팅 서비스
- 정보가공 서비스
- 상표조사 서비스

IPRIS 인터넷 서비스 : 02-3452-8144(교320) (www.kipris.or.kr)
선행기술조사서비스 : 02-3452-8144(교590) (www.forx.org)

한국특허정보원
Korea Institute of Patent Information

한국특허정보원
Korea Institute of Patent Information

서울특별시 강남구 역삼동 647-9 한국지식재산센터(KIPS)
전화 : (02) 3452-8144
FAX : (02) 3453-5951

특허기술정보서비스 : www.kipris.or.kr
선행기술조사서비스 : www.forx.org